

番号	意見	回答
1	わが国と信頼関係を築くことができない国々が世界中に存在します。軍事的に重要な位置を占める財貨の輸出にあたって厳しく管理を行うことは当然であり、今回の改正案に賛成します。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
2	半導体製品製造装置及びその関連技術は、昨今技術の進歩が著しいAI技術や兵器転用技術等に利用可能です。それ故、米国、オランダ等と足並みを揃えることは、「力による現状変化を認めない」という日本の立場にも合致します。また迂回経路をゼロにすることは困難ですが、上記の様な懸念国との貿易割合が多い国にも「特別一般包括許可」か、それより厳しい「特定包括許可」や「個別許可」のみにする必要を強く感じます。また同様の理由により、グループAや「一般包括許可」の対象は現状維持が良いでしょう。抜け道を根絶するのは困難ですが、リスクは極力減らしてもらいたいところです。以上の理由により、本改正案に賛成します。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
3	昨今のウクライナ情勢や、台湾、尖閣諸島での緊張状態を鑑みると、日本の国土、国民の生命、財産を守る手段は多数用意する必要があると考えます。日本の技術を使用して、日本に損害を加えられないよう手段を講じて頂きますよう宜しくお願い致します。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
4	輸出管理に於いて相手国との信頼関係を保てるが一番の問題です。同盟国や価値観が一致又は近い等も必要ですが、韓国政府の様に政権が変われば全て変わってしまう国との輸出管理は厳しくしないと、日本国の国益を削ぐ事になります。原子力供給国グループ（NSG）、オーストラリア・グループ（AG）、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）、ワッセナー・アレンジメント（WA）に属しているだけでグループA地域にしてはいけません。ハッキリ言って韓国は竹島不法占領その他多数の国際法違反条約違反を繰り返す無法国家である。ロシアとなんら変わらない国である事から軍備に関わる輸出品管理は厳格にしなければ日本国の安全国益は守れません。価値観の共有できる国と価値観の違う国はハッキリと分けて管理すべきです。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
5	本改正案に賛成します。理由としては、半導体製品製造装置やその関連技術は、兵器転用技術等に利用可能であり、厳格な輸出管理が必要と考えるためです。軍事転用防止に資する改正案を支持します。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
6	ウクライナ、ロシアとの戦争、中国の武力による現状変更のおそれ、北朝鮮の核・ミサイルの脅威、韓国の輸出管理のずさんな状況が継続している等、昨今の世界情勢を踏まえ、このたびの経済産業省の輸出管理の厳格化、ワッセナー・アレンジメントの補完措置に賛成いたします。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
7	大賛成です！安全保障の厳しさが増す中、当局の素晴らしい決定を一国民として支持します！	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
8	一般的な話となりますが、今回の規制は装置そのものが対象となるのか？それとも、規制に該当する装置に使用する部材関係も対象となるのか？もし部材関係も対象となるのであれば、経産省への届け出が必要となるのか？どこまでの範囲が規制対象となるのかを指針を示していただきたい。	貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要な不可欠であるか否かとなります。
9	賛成します。加えて、ワッセナー・アレンジメントへの法的拘束力を追加頂きたい。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
10	中露朝と、その思想を同じくする、武力で他国の領土主権を脅かそうとする勢力、及びそこに転売するおそれのある国に対して、兵器転用も可能な物資の輸出を輸出を許可することは、日本の国益になりません。一層の管理制度の強化を希望します。また違反のあった場合の罰則も強化して欲しいと思います。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
11	<ul style="list-style-type: none"> ・輸出貨物が汎用品の半導体搬送ロボットの場合、単体(半導体搬送ロボット)ではリスト規制に非該当と判断しています。このとき、半導体搬送ロボットの使用(搭載)される半導体製造装置が規制対象の場合には、経産省への許可申請が必要になるのでしょうか。また、規制対象として許可申請が必要になる場合、装置の部分品としてリスト規制への対象と考えるのでしょうか。若しくは、キャッチオール規制の用途への対象と考えるのでしょうか。 ・追加される品目として、輸出令別表1の17項のルーフ、17項の2となり、部分品、附属品も含まれると考えますが、輸出令別表1の17項のルーフ、17項の2の部分品、附属品の設計、製造に必要な技術やプログラムも規制対象になるのでしょうか。また、上記の技術やプログラムが専用品と汎用品の場合、規制の対象有無の考え方は違ってくるのでしょうか。 ・中国の現地子会社が今回の規制品目を生産していると仮定した場合、日本の法令対象になるのでしょうか。今回の改正案の内容を見る限り域外適用に関する内容は無いため、対象にならず当該国の法令を遵守すれば良いとの考えになるのでしょうか。規制対象となる場合、例えば下記への輸出をする際にはどの場合が対象になるのでしょうか。 1.中国→日本 2.中国→中国 3.中国→第3国 ・半導体製造装置23品目の貨物等省令追加について5月公表、7月施行とのことですが、規制対象となった場合、輸出するためには包括許可が必要になるとありますが取っていないとき、申請しているが取れていないときはどのようになるのでしょうか。必要になる場合は、7月の施行予定日以降に輸出される貨物等が対象になるとの考えでよろしいのでしょうか。また、7月の施行以前までに輸出(例：船積みされているもの)されるものは規制対象外と考えてもよろしいのでしょうか。 ・包括許可が利用できる範囲として 1.包括許可を申請する際、設計・製造の技術・プログラムについて、区分の該当有無が分かりにくいのですがどのようになるのでしょうか。また、中国は「と地域3」になることが考えられますが、該当項番に関係なく「特定包括許可」が該当するようになるのでしょうか。 2.設計・製造の技術・プログラムについて、半導体製造装置等の23品目の追加案に伴ってメール送信も規制対象として許可申請が必要になるのでしょうか。 3.海外の子会社(グループA)で製造するために技術を渡す際にも、包括許可申請が必要になるのでしょうか。 ・設計意図が「ウエハー搬送装置専用ロボット」の場合、7の項(16)で追加規制される半導体製造装置専用に設計されたものではなく非該当になるとの判断となるのでしょうか。今回の追加規制では半導体製造装置専用の部分品、附属品としての判断となるのでしょうか。追加規制での部分品、附属品の判定について教えてください。 	貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要な不可欠であるか否かとなります。今回の措置は、新たに23品目をリスト規制に追加するものですが、法令の運用等において従前から管理対象となっている装置との違いはございません。なお、今回の措置は、従前の改正と同様、施行日以降に輸出される貨物が対象となります。
12	17号ヤ、マ、ケがあるが、たとえば、枚葉式のウェット洗浄装置について、XXXを有するという付加的機能や付加的技術などのコンディションをつけずに、すべて。としてしまうと、半導体の微細化による軍事転用されない汎用の洗浄作業まで規制をかけてしまい、我が国の健全な経済活動までも阻害しかねない。安全保障を脅かすか、否か、を詳細な仕様を起こして、貨物等省令の内容をきめるべきだと思います。	御指摘の品目については軍事転用のおそれがあると考えており、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。
13	<ul style="list-style-type: none"> ・ベリクル製造装置に関して 1. 省令改正案第六条17号 ベリクル製造装置を省令により規制対象にしようとする根拠が不明です。ベリクル(=フォトマスク用防塵カバー※)製造装置は「半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品」、「マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品」のどれにも当てはまらないと考えられるにもかかわらず、17号ルにベリクル製造装置を新設しようとしています。 ※ https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/2021/2021_0526.htm#:~:text=2%20E3%83%9A%E3%83AA%E3%82AF%E3%83AB%E3%81AB%E3%81A4%E3%8184%E3%81A6-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82AF%E7%94%A8%E9%98%B2%E5%A1%B5%E3%82AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%82,-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82AF%E3%82%92 2. 省令改正案第六条17号ル 「ベリクル(極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したものに限る。)を製造するための装置」とは、どのような装置かを解釈で明示すべきだと考えます。ベリクルをフォトマスクに貼り付ける装置のことを指しているのか？対象貨物が不明確です。 ・EUVマスクを省令に追加せず、EUVベリクルのみを追加しようとしている理由は何か？(仮に、省令改正前からEUVマスクが規制対象だったとすれば、その附属品としてEUVベリクルも規制対象に含まれていたと考えられ、EUVベリクルの省令追加は不要ではないか？) 	ベリクル製造装置については、輸出貿易管理令別表第一の7の項(16)「半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置」に該当すると考えております。また、貨物等省令第6条第17号ルでは、ベリクルそれ自体を製造するための装置を管理対象としております。今回追加する23品目については、軍事転用の防止の観点から、必要最小限のものを選定しております。
14	先端のメモリー、ロジックだけではなくどのような用途に使用するののかも検討に加えた方が良いと思います。特にこれから確実に伸びていくパワー半導体分野に関しては中国が補助金を投じてものすごい投資をかけています。現状だと液晶、太陽電池のように負けてしまう可能性は高いように思います。	いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
15	本改正案については中国でも大きな反響を呼んでおります。「中国を名指しにするものでなく、広く全世界を対象にしています」という経産相及び外相によるご説明あるも、納得は得られておりません。特定の向け先(と地域3)には特一包括制度が使えない、台印星南ア向けには使えるという事実を、現地でも知る人は知っているからです。パブコメに付された以上大枠を覆すのは困難と存じますので、今後の運用と情報公開につき是非建設的なご対応を願いたく、以下意見を申し述べます。今般の対象貨物・技術の中国向け個別輸出許可申請について、あたかも原則不許可(Presumption of denial)の方針であるかのような外野の論調も目立つところ、審査方針並びに審査結果データの透明化をご検討願います。具体的には、許可・不許可・不受理の各件数を可能であれば2回程度公開していただきたいと考えます。併せ、不受理に至るケース及び許可されるケースの必要十分条件等を差支えない範囲で公表いただけること、輸出者による理解賛同とひいては中方またはあまねく外国へのアピールと相互理解に資するのではないかと思料しております。以上が申し述べたい意見となります。以下若干蛇足ながら、19年に始まり近々収束を見るかもしれない韓国向け半導体材料の輸出管理強化についても、本省またはCISTEC殿等を通じ可能な範囲で一連の顛末を総括として情報公開されることを希望します。規制ばかりではなく緩和もありえるというのは中方にも有効なメッセージたりえると考えますし、何より輸出管理の政治利用といういわれのない非難を打ち消す材料となりえると信じるためです。	今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、御指摘のように特定の国を念頭に置くものではなく、国際ルールに整合的に実施するものです。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。
16	改正案では輸出令別表第一の七の項の範囲を超えた規制をしようとしているのではないかと新設しようとするベリクルを製造するための装置は、ベリクルを製造するものであり、「半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置」のいずれにも当たらないと考えられる。輸出令の改正なしに規制できないのではないかと？	御指摘の品目については、輸出貿易管理令別表第一の7の項(16)「半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置」に該当すると考えております。
17	EUVベリクルは、EUVマスクの附属品ではないのか？EUVマスクは明示的に規制されていないなかで、EUVベリクルのみ明示的に規制する理由が理解できない。安全保障貿易審査課で審査したいのかもしれないが、マスクの附属品であるなら改正後17の2号ではなく、現行17号で規制がかかるのではないかと？	御指摘の品目については、輸出貿易管理令別表第一の7の項(17)「マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(10の項の中欄に掲げるものを除く。)」に基づくものですが、法技術的な理由により貨物等省令第6条第17号の2を新設するものです。

	<p><該当箇所> 貨物等省令第6条第十七号 包括許可取扱要領別表A <意見内容> 規制対象品目には装置のみならず当該装置の部分品が含まれており、且つ仕向地が「と地域3」の場合でも特別一般包括許可は適用できず、個別許可を申請すべきものとなっております。この内、輸出者が施行前に締結した契約(包括的なものを含む)に基づき施行後に当該品目を提供するものに関しては、原則として許可が得られるようご配慮をお願い致します。 <理由> 弊社は半導体製造装置メーカーですが、装置の販売に際しては、保守・サービス契約を同時に顧客と締結するケースが一般的であり、当該契約締結後に販売済み装置(今般規制対象品目となるものを含む)の部品(部分品規制の対象となる専用部品を含む)に起因した不具合が生じた場合、代替部品の提供義務が生じることとなります。当該契約締結時点では規制対象となることは全く想定されていないことから、文言上の措置は講じられておらず、もし個別許可が得られず部品を提供できない場合、債務不履行として顧客から損害賠償を請求されるおそれがあります。</p>	<p>今回の措置は、従前の改正と同様、施行日以降に輸出される貨物が対象となります。御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
18	<p><該当箇所> 提出書類通達別表1 包括許可取扱要領別表A <意見内容> 規制対象品目となる装置を「と地域3」に輸出する場合、個別許可を申請することが必要となり、当該申請に際し、所定の最終用途誓約書を取得することが求められています。最終用途誓約書では、当該装置を客先から再輸出する時に経済産業省の事前同意を義務付けているものの、国内第三者への移転に際しては当該対象とはなっておりません。国内外問わず客先からの再移転について、事前同意を義務付けるべきではないでしょうか。 <理由> 半導体製造装置は非常に高価であることから、一定規模の中古マーケットが存在しており、売買も活発に行われております。今般の品目は従前の半導体製造装置に比べ特に厳格な規制対象となっていると理解しており、許可が得られた客先から同一国内の本来許可が得られない企業等への移転も管理すべきではないかと考えます。</p>	
	<p><該当箇所> 貨物等省令第6条第十七号ラ <意見内容> 本箇所により規制される対象が先端プロセス向けの装置であることを、より明確化する条文として頂くことを希望致します。 <理由> 改正案として提示された条文では、一部先端的ではないプロセス向けの装置が該当するようにも読めるおそれがあると考えます。</p>	
19	<p>17のケ「ウエハーの表面改質の後に乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置」の解釈について、次の5点をご回答頂きたくお願い致します。 1) 「ウエハー」の解釈について、「ウエハー」メーカーの場合は、輸出令7項(17)の「半導体素子、集積回路若しくは・・・」を踏まえて用途確認し、これに該当する場合に許可申請が必要であると理解してよいですか。 2) 「ウエハーの表面改質」の解釈について、例えば、ウエハーの表面粗さを小さくすること(研磨)は表面改質に当たりますか。また、酸化等によるウエハー表面の材質変更、レジスト塗布やメッキ、蒸着等によるウエハー上への異物の付着積層、エッチング等によるウエハー材又は積層物の除去、表面形状変更等は表面改質に当たりますか。 3) 「洗浄装置」はウエハーの汚れを除去する装置と考えます。また、前1)及び2)で質問したように「ウエハーの表面改質」には解釈があると考えます。よって、この17のケに従えば、「枚葉式のウェット洗浄装置」の取引都度どのような「ウエハーの表面改質」用途で使われるかの用途確認をして許可申請要否を判断する必要があると考えます。この17のケは、用途確認して許可申請要否を判断する方法で輸出管理することを求めていると理解してよいですか。「枚葉式のウェット洗浄装置」の該非判定スペックには、例えば、除去後の評価指標となるウエハー上のコンタミサイズと数量、除去する物の材質や物性等、または洗浄速度(時間当たりのウエハー洗浄枚数)などが考えられると思うのですが、このようなスペック検討が困難であるとか、輸出管理の目的を満足しないということですか。 4) 「乾燥を行う工程」の解釈について、ウェット洗浄装置の場合、濡らしますから乾燥します。例えば、自然乾燥、湿度、温度、送風、真空、若しくはガスバージ、アルコール揮発等の何らかの操作や条件が考えられます。また、乾燥能力としては、例えば乾燥速度(乾燥時間)などが考えられます。よって、「乾燥を行う工程」と書いている理由は、該非判定スペックを付帯するためと推察しました。つきましては、解釈のご開示をお願い致します。 5) 「乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置」が「ウエハーの表面改質」と一体になっていない装置の場合、「ウエハーの表面改質の後に」をどのように判断すればいいですか。</p> <p>当社の3項(2)に該当する製品は、主に半導体製造を目的とする薬液を移送する装置用(7項(17)ケに該当する洗浄装置にも使用される)の部品として使用されるために、様々な商流を通じて中国を含む「と地域2」の各国に輸出されています。法改正で「と地域2」の各国で7項(17)ケに該当する洗浄装置に使用される3項(2)に該当する製品及び16項該当の製品の場合について、以下の通り質問します。</p> <p>3項(2)に該当する製品が国内で7項(17)ケに該当する洗浄装置に組み込まれて「と地域2」に輸出される場合、装置メーカー等の装置輸出者は、従来は組込みによって16項該当品になるため輸出許可申請が不要でしたが、法改正後は7項(17)ケに該当するために輸出許可申請が必要になります。それでは、3項(2)に該当する製品を輸出するときの許可申請の要件として、外国で7項(17)ケに該当する装置に組み込まれるか否かを確認する必要がありますか。また、キャッチオール規制の製品(16項該当の製品)を輸出するときの取引審査で、7項(17)ケに該当する装置に組み込まれるか否かを確認する必要がありますか。※いずれの輸出製品も汎用品とします。</p> <p>この質問の真意は、国内で7項(17)ケに該当する洗浄装置のメーカーと競合する外国の装置メーカーにどう対応すべきかを伺いたいたためです。例えば、既に取引のある装置メーカーや、法令改正の対応として外国に生産拠点を移す装置メーカーや、今後、成長する外国の装置メーカーを考えています。いずれも当社の顧客に変わりはないですが、経済産業省に外為法のバックフィル企業と判断される状況になると考えますので、お考えを伺いたく思います。尚、国内の装置メーカーが許可されない取引が開示されなければ、バックフィルかどうかの判断はできません。例えば、許可要件を明示してバックフィルへの対応方針を示して頂くという方法が考えられます。許可要件としては、例えば、米国規制のように先端半導体の製造かどうかを確認するという方法が考えられます。その場合には先端半導体の定義をお示し頂きたくお願い致します。今回の法令改正は、企業にバックフィルへの配慮を求めているのかをはっきりして頂きたいと考えます。ご回答がいずれの場合だとしても従うべきことと考えていますので、よろしくお願い致します。</p> <p>2021年11月18日より半導体製造用ポンプ・バルブについて、特別一般包括許可の適用範囲が拡大されています。この制度によって輸出可能になっている最終需要者(半導体メーカー等)については、本件の改正に伴って再審査が行われ、取り消される場合があると考えておくべきでしょうか。取り消しは改正法施行日から適用されると考えておくべきでしょうか。その再審査で取り消しとなった半導体メーカー等との取引は輸出許可されないと考えておくべきでしょうか。輸出許可されない半導体メーカー等があるとすれば、外国ユーザーリストのような何らかの方法で開示されるでしょうか。</p>	<p>御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。 御指摘の貨物等省令第6条第17号ケは、輸出貿易管理令別表第一の7の項(16)の「半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは付属品」としての「洗浄装置」を対象とするものです。また、一連の工程としてウエハーの表面改質の後に乾燥を行うことを想定しています。また、貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・付属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かとなります。なお、今回の措置に該当する場合は、今回の措置に基づく許可申請手続を行っていただく必要があります。</p>
20	<p>確認です。改正後省令第6条十七の末尾の「これらの部分品若しくは付属品」という文言は、規制対象本体「専用」の「部分品若しくは付属品」を指し、いわゆる「汎用品」が規制対象本体に組み込まれた部分品もしくは付属品の場合は、これに当たらず規制対象ではありませんね？</p>	<p>貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・付属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かになります。</p>
21	<p>・意見内容 ① 輸出令 第六条十七項マについては、対象となる半導体製造装置が不明確であり、且つ同条下記項でドライブプロセスの対象装置が明確に示されており、先端半導体製造に適さない装置も広く含まれる同項「マ」の削除を希望します。 第六条十七項 カ 第六条十七項 タ 第六条十七項 レ(五)の1 第六条十七項 ウ(二) ・理由 本改正にて新設された項目の内容から、ロジック半導体等の先端半導体の製造用に設計された装置(以下、先端半導体製造装置)が対象と読み取れます。先端半導体製造装置に適さないプラズマを利用した物理的および化学的成膜装置は、世界中で製造されており、プラズマ発生によるドライブプロセスでの酸化膜や汚染物の除去機能は特別な機能ではない。また、先端半導体製造装置は特別な仕様の装置であると考えられ、それ以外のプラズマを利用した物理的および化学的成膜装置で先端半導体を製造することはできない。上記理由より、前記の「第六条十七項マ」は、対象となる装置が広範となることから、削除が適当であると考えます。又は、「先端半導体製造装置に適さないプラズマを利用した物理的および化学的成膜装置」は規制対象外である旨明記して規制範囲を明確にするのが適当と考えます。</p>	<p>御指摘の品目については軍事転用のおそれがあると考えており、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。</p>
22	<p>高性能な半導体製造装置23品目を輸出管理の対象に追加することは、我が国の経済安全保障にとって極めて重要であり、賛同いたします。半導体製造装置の輸出はメンテナンスを伴い、人材も派遣する必要があります。従って、技術、ノウハウの流出に繋がりにかれません。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
23	<p>中国向けの輸出に関し、日系企業や同志国企業向けの輸出についても例外なく、実績が積みあがるまで個別輸出許可が必要だと思いますが、一般的に日系企業や同志国企業については安全保障上の懸念度は低いと考えられます。日系企業や同志国企業向けの輸出については、以下の2点を要望致します。 1) 特定包括の要件緩和 2) 懸念度合いに応じた迅速な審査</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
24	<p>今回の改正は、輸出貿易管理令 別表2の7項 エレクトロニクスのみ改正のようですが、それを含んだ8項や9項は何も変更はないのでしょうか？8項や9項については7項で規制のある製品を含んでいたとしても最終製品が8項・9項で分類されるものに関してはいままでどおりということになりますか？EARでは規制アイテムを含む電子計算機についても規制対象となることから日本の輸出規制とのギャップとなるのかを含めて改正検討を行っていただけますようお願い致します。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
25	<p>先端プロセスに関わる部分に限定して規制をかけることには理解はできるが、先端でないものに関してでも規制がかかっているように見受けられるので、そのあたりは明確にして頂きたいと思います。また装置だけではなく日本が多くのシェアを持つ素材にまで規制をかけた場合、産業界に与える影響が非常に大きい為、これ以上規制を拡大しないようにして頂きたい。規制をかけた場合、相手先はあきらめることなく、何とか使用できるように自国での開発を促すことになり、日本企業は相手国の市場を失うだけでなく、相手国の企業が台頭することにより、ワールドワイドでシェアを減少させることになる。この結果、日本の産業界全体が落ち込み、日本の弱体化につながる。上記の理由から、規制を更に拡大することをせず、先端プロセスに限定した規制に留めるべきだと思う。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

26	<p>・該当箇所：省令案の全般 包括取扱要領の一部改正案</p> <p>・意見内容</p> <p>1.今次改正により拡大される予定のリスト規制（List Control）の範囲とキャッチオール規制（Catch-All Control）との関係について： 今次改正による従来のリスト規制範囲の大幅な拡大は、現行のリスト規制及びキャッチオール規制の機能の枠組み及び趣旨と合致せず、従来の正常な輸出入貿易に不要な干渉及び影響を与えるものと懸念されます。</p> <p>2.許可便宜政策の確実性について： 手続が整った状況下において特定包括許可を受けられるのか否か、それをいつ受けられるのが極めて不確定ですので、この点をさらに明らかにし、越境取引の展開を円滑化することが提案されます。</p> <p>3.今次改正の移行期間について： 既存の契約の履行に便宜を与え、不要な紛争の発生を避けるため、「既に締結された契約には遡及しない」旨の文言を追加し、あるいは一定の移行期間を設けることが提案されます。</p> <p>・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。）</p> <p>1.の理由について： リスト規制自体は、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを対象とするもので、法令等によって明確に規定されます。リスト規制のほか、日本の現行の安全保障管理制度においてはキャッチオール規制も定められ、リスト規制対象の貨物、技術でなくとも、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。貴省の『安全保障貿易管理ガイドンス【入門編】』（第2.1版、2022年12月）には、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれの高い貨物が列挙されています。今次改正の意見募集要領によると、今次改正の趣旨及び目的は「軍事転用の防止」にあります。私は、現行のキャッチオール規制制度によってこの趣旨及び目的は既に実現可能であると考えます。しかし、今次改正で管理リストに追加される予定の品目が関わる範囲は非常に広く、ワッセナー・アレンジメント等の多国間輸出管理制度が対象としていない品目を多く含むと同時に、これらの品目は長年にわたり半導体産業において常用される民間用の品目とみなされ、「大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれ」は極めて僅かです。したがって、今次改正による従来のリスト規制範囲の大幅な拡大は、現行のリスト規制及びキャッチオール規制の機能の枠組み及び趣旨と合致せず、従来の正常な輸出入貿易に不要な干渉及び影響を与えるものと懸念されます。</p> <p>2.の理由について： 今次改正によると、「と地域③」（中国等が含まれる）の国・地域への輸出について追加される予定の23品目については、一般包括許可（General Bulk Export License）及び特別一般包括許可（Special General Bulk Export License）が適用されず、特別包括許可（Special Bulk License）又は個別許可を申請するしかないものとされています。特別包括許可の申請に関し、包括許可取扱要領（2023年3月23日改正・施行）はその要件や必要な書類等を定めていますが、審査に要する時間や、要件を充足する場合に確実に許可が下りるか否かについては定めておらず、すなわち、手続が整った状況下においてその特定包括許可を受けられるのか否か、それをいつ受けられるのが極めて不確定ですので、この点をさらに明らかにし、越境取引の展開を円滑化することが提案されます。</p> <p>3. の理由について： 今次改正の前に契約が締結されていたものの、実際の引渡しはまだ行われていない品目について、今次改正前の安全保障貿易制度の下では、許可を受ける必要がありません。しかし、今次改正が施行されると、一転して許可が求められます。こうして、売主たる日本企業が契約を履行できなくなり、場合によっては巨額の賠償責任を負う事態にもなりかねません。したがって、既存の契約の履行に便宜を与え、不要な紛争の発生を避けるため、「既に締結された契約には遡及しない」旨の文言を追加し、あるいは一定の移行期間を設けることが提案されます。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものです。また、今回の措置も、従前の改正と同様、施行日以降に輸出される貨物が対象となります。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
27	<p>【質問1】</p> <p>輸出貿易管理令別表第1の7の項（16）並びに輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第6条第17号本文の「部分品若しくは附属品」（以下「部品」といいます。）は、「輸出貿易管理令の運用について」（輸出注意事項62第11号・62貿易第322号（S62.11.6）経済産業省 貿易経済協力局）1・1（7）イ「輸出令別表第1の解釈」において「他の用途に用いることができるものを除く。」とされているところ、「他の用途に用いることができるか」否かの判断方法をご教示ください。なお、輸出管理ガイドンス〈エレクトロニクス〉（2023年、安全保障貿易情報センター）284?285頁によれば、下記（i）から（i i i）により判定されるところですが、経済産業省としても同様の理解でよろしいでしょうか。</p> <p>（i） 該当の半導体製造装置・試験装置に使用することを意図して設計されたものであり該当となる機能・性能に必要不可欠なものは、半導体製造装置・試験装置の項番に関して該当となる。</p> <p>（i i） 非該当の半導体製造装置・試験装置に使用することを意図して設計されたものは、半導体製造装置・試験装置の項番に関して非該当となる。</p> <p>（i i i） 該当と非該当の両方の半導体製造装置・試験装置に使用することを意図して設計されたものであって、該当の半導体製造装置・試験装置が該当となるために必要不可欠なものは、半導体製造装置・試験装置の項番に関して該当となる。</p> <p>【質問2】</p> <p>質問1に記載した輸出管理ガイドンス〈エレクトロニクス〉に記載の判断基準が採用される場合、（i i i） 該当と非該当の両方の半導体製造装置・試験装置に使用することを意図して設計された部品の該非判定においては、「該当の半導体製造装置・試験装置が該当となるために必要不可欠なものであるか」という点を判断する必要があると理解しています。部品の製造メーカーが、特定の半導体製造装置・試験装置に用いられることを想定していない部品を輸出する場合、当該部品が「該当の半導体製造装置・試験装置が該当となるために必要不可欠なものであるか」の判断を正確に行うことは困難ですが、「該当の半導体製造装置・試験装置が該当となるために必要不可欠なものであるか」の判断方法をご教示ください。例えば、部品の製造メーカーにおいて、供給先に「当該部品は当該装置がリスト規制該当となるために必要不可欠なものではない」又は「当該装置はリスト規制該当ではない」旨、確認することをもって、当該部品を非該当と判定することは許容されますでしょうか。</p> <p>【質問3】</p> <p>質問2に関連して、部品の製造メーカーにおいて、半導体製造装置の製造メーカーに「当該部品は当該装置がリスト規制該当となるために必要不可欠なものではない」又は「当該装置はリスト規制該当ではない」旨、確認しようとする場合であっても、半導体製造装置の製造メーカーが自社の装置について確定的な該否判定に至らず、部品の製造メーカーからの確認に対して回答しないことも想定されます。その場合、部品の製造メーカーとしてはどのように判定すればよいのでしょうか。半導体製造装置の製造メーカーから開示されている情報では貨物等省令に規定されているスペックを満たすか否かが判断できない、つまり「必要不可欠」でないことが明らかでない以上、すべて該当として許可申請することになるのか、あるいは、リスト規制に該当する装置の専用として設計された部品ではないことをもって非該当と判定することも許容されるのか、考え方についてご教示ください。</p>	<p>質問1については、今回追加される半導体製造装置について、御質問の点に関して従前から管理対象となっている装置との違いはございません。</p> <p>質問2については、部品メーカー自身が半導体製造装置用と意図して設計したものである場合や、半導体製造メーカーから指定された仕様、機能等に従って製造したものであって該当となる機能・特性に必要不可欠なものである場合、該当する半導体製造装置用の部分品の可能性があるため、半導体製造メーカーへ証跡が残る形で確認してください。なお、部品メーカー自身が半導体製造装置用と意図して設計していない場合や半導体製造メーカーからの指定等はなく、半導体製造装置以外の用途も想定した設計部品であれば、解釈欄に記載のとおり、「他の用途に用いることができるものを除く。」の範囲と考えられます。</p> <p>質問3については、貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かになります。</p>
28	<p>日本経済産業省が3月31日から意見募集している省令改正案に対し、大いに懸念しております。本改正案の内容には多数の民生機器が含まれ、規制対象品目は広範囲に及びます。実施されれば、中日半導体分野の経済貿易協定と技術交流に重大な悪影響を与えてしまうことになります。従って、以下のとおり提言させていただきます。</p> <p>1.本改正案の管理対象リストの品目は、通常の規制範囲を超えるものである。</p> <p>改正の対象となる規制品目はあまりにも広範囲であり、中日企業の半導体分野における正常な経済貿易活動に深刻なダメージを与えることは必至です。例えば第6項では、メモリーチップに多用される特定のドライエッチング装置がリストに入っておりますが、関連装置は主にDRAMなどのメモリーチップに使用されます。各国がメモリーチップの中国向け輸出を制限していない中で、日本はメモリーチップの製造装置の輸出を制限しようとしています。関連制限措置を解除するよう要請します。</p> <p>2.本改正案は特定国に対する差別的な措置である。</p> <p>西村経済産業大臣は記者会見で、今回の措置は特定の国を対象としたものではないとしながらも、42の国と地域以外は案件ごとの個別許可制を採用すると述べておられます。これは法律上のみならず、事実上にも中国に対する深刻な差別的措置になります。中国は日本の半導体装置の最大の輸出先であり、多くの企業が日本から半導体製造装置の導入を必要としています。日本政府におかれましては、中国企業に対し、他の42の国と地域の企業と同様の政策措置を講じるべきさものと考えます。</p> <p>3.本改正にかかわる許可審査基準は透明性に欠けるものである。</p> <p>西村経済産業大臣は、「関連措置は『禁輸』ということではなく、強化していくということであり、軍事転用のおそれなければ、通常どおり輸出ができる」と述べておられますが、審査の具体的な基準と判断の根拠を公開していません。審査基準は何か、どのような状況で「軍事転用のおそれがなく通常どおり輸出ができる」のか、明示していただけますよう要請します。日本政府におかれましては、本改正が日本の半導体関連企業及び産業全体に与える影響を慎重に評価し、適時に関連措置を見直し、本改正が中日半導体産業の現在そして将来の協力のための不必要な障害とならないよう取り計らわれることを期待しております。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、特定の国を念頭に置くのではなく、国際ルールに整合的に実施するものです。審査基準の詳細につきましては、安全保障上の理由からお答えは差し控させていただきます。</p>
29	<p>3/31に公開された外為法改正案で、輸出令別表1の7の項に新たに高性能な半導体製造装置23品目が輸出管理の対象となりましたが、下記点について弊社の認識に問題がないかご教示をお願いできますでしょうか。</p> <p>Ⅰ 弊社製品のうち、輸出令別表1の2項（31）、または10項（8）の（レーザー発振器）で該当品となる製品があり、それらが、弊社客先で7項で該当品となる装置に組み込まれますが、弊社製品は7項で該当品となる装置専用に設計製造された製品ではないので、「7項に該当する製品のために専用設計された部品」には当たらず、規制の対象にはならない。</p> <p>Ⅱ 非該当の製品でくみ上げた構成品（10項（8）（レーザー発振器）で非該当の製品）があり、客先の非該当の装置用に専用設計されたものがありますが、客先の装置自体が7項の規制品ではないので、そもそも7項の規制の対象にならないと認識しています。が、10項（8）で非該当の製品でくみ上げた構成品が客先の7項の該当品の装置のために専用設計されたものであっても、客先の装置が該当品となるための性能に到達するために必要不可欠な必須構成品ではないので、弊社製品は7項の対象にならない。</p> <p>Ⅲ 客先から10項（8）で該当になる製品の注文があり、その製品が客先が海外エンドユーザに納品済みの7項で該当品の装置に組み込まれることが判明している場合、弊社ではなく、輸出者である顧客が外為法に沿った輸出手続きを行う必要があり、また、弊社は製品を国内顧客に納品する際は、特に外為法上の規制の対象にはならない。</p> <p>Ⅳ 3/31に公開された外為法改正案で規制されている外為令7項（二）役務は「使用するために設計されたプログラム」とありますが、海外エンドユーザに納品済みの7項で該当品となる装置に不具合がでた場合、弊社社員が海外エンドユーザの施設に行き、（現地の人間には作業内容を見せず、現地の人間と作業中は接触せず）プログラムはいじらず、装置の性能を本来の性能に原状回復させるための部品交換、メンテナンスを行う場合は、外為法の役務の取引許可は不要。</p>	<p>貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かになります。なお、輸出許可申請の手続は、輸出者が行っていただくこととなります。また、今回追加される半導体製造装置について、御質問の点に関して従前から管理対象となっている装置との違いはございません。</p>

30	<p>提出意見：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 貨物等省令第6条第17号「(カ)ドライエッチング用…」以降「(ケ)ウエハーの表面改質…」まで ・意見内容 規制製品について、規制目的に照らして懸念度の低い輸出であれば、手続きの簡素化への配慮を頂ければと思います。 具体的には、今回新設される規制については、米国・オランダ所在企業あるいはその海外子会社（グループA国以外の国を含む）向けの輸出を適用対象外とし、個別許可・包括許可ともに不要とするなど、適用範囲を限定する措置をおとりいただきたく。 ・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 規制の目的は軍事技術に使われる恐れがあるスパコンやAI半導体の開発を抑え込む事と理解しますが、規制の内容は先端半導体に限らず汎用半導体にも使われる多くの成膜装置をはじめとした各種半導体製造装置が対象になっていると思われ、仕向先を限定せずに適用するには、規制の目的に鑑みるに広範に過ぎる内容と考えます。例えば、貨物等省令第6条第17号で規制される成膜装置は、米国EARにおけるECCN3B090の規制内容と重なりますが、米国では当該規制は主に中国向けに限定して適用されます。 <p>また、私共は半導体製造装置メーカーの同装置部品サプライヤですが、半導体製造装置の部品の規制該非は、当該部品が搭載される装置の性能によります。したがって、半導体製造装置の部品の輸出にあたっては、機密扱いであり一般的に知る事は出来ない搭載装置の具体的な性能について、装置メーカーへの聞き取りを行うほか、ケースによっては輸出許可申請の業務が必要になります。その中で広範な規制の新設は、こうした輸出管理のためのコスト増が懸念されるほか、装置メーカーの情報の信頼度に因っては、自社の輸出する部品の規制該非を明確に判断できず、自主判断で商売を諦めざるを得ない状況になりかねません。こうした点からも、規制範囲をその目的に照らして必要十分なものとしていただきたい次第です。</p> <p>なお、事業者の事業の自粛を招くような規制は、日本企業の撤退を通して新たな地場メーカーの成長を促す機会となり兼ねず、規制の目的と真逆の効果を生む可能性も否定できないと思われま。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
31	<p>1. 国際輸出入とのプロセスの一貫性を図る： a) 書類のチェックリスト、ワークフローの指示、明確な審査サイクルタイムを含む透明性の高い手順など、国際基準を満たすライセンシングプロセスと実務を採用する。</p> <p>2. 技術および規制の一貫性を図る： a) 技術を理解し、文書化された規制が意図した目的を達成できるようにするため、半導体業界全体の技術及び輸出管理規制の専門家と連携し規制対象品目の明確な記述を含むことを確認する。</p> <p>3. ライセンスの免除と考慮事項： a) 国や閾値に基づくライセンス免除を導入する。 b) 修理・返品、保証期間中の機器、スペアパーツ、企業間移動の場合。 c) 以前に認可された機器の使用、設置、校正、メンテナンス、オーバーホール、修理、更新またはアップグレードに必要なソフトウェアおよび技術の移動・譲渡の場合。 d) 同一企業に対して発行された他国（米国・EU）の輸出ライセンス（輸出許可書など）を考慮・参照する場合。</p> <p>4. ライセンスの有効期間： a) ライセンスの有効期間を長くし、スペアパーツ（技術・ソフトウェア）もカバーすることを推奨する。ライセンスの有効期間をそれぞれ3～4年に延長することを提案する。 b) 部品・スペアパーツの一般的なライセンス手続きに柔軟性を持たせるべきである。</p> <p>5. 域外管轄権 適用範囲： a) 域外適用がある場合は、日本が明確なガイダンスを持つことを推奨する。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただくとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
32	<p>・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 第六条十七 マ 複数のチャンパー又はステーションを有する装置であって、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの</p> <p>・意見内容 複数のチャンパー又はステーションを有する装置であって を 複数のチャンパー又はステーションを有する洗浄又は除去装置であって とする</p> <p>・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 複数のチャンパー又はステーションを有する装置は、多種あるので、洗浄が主たる装置であることを明確にするため。</p> <p>・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 第六条十七 ケ ウエハーの表面改質の後に乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置</p> <p>・意見内容 ①枚葉式のウェット洗浄装置であって、ウエハーの表面改質の後に不純物を除去し、乾燥を行う工程を有するもの に言い換える ②ウエハーの表面（回路パターンを生成する側面を言う）（ ）書きを追加する ③改質（成膜及び、露光及び、ドライエッチング時によるものを言う）（ ）書きを追加する</p> <p>本文の修正が適わなければ、解釈やQ&Aで解説を希望します。</p> <p>・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） ①装置の主たる機能が洗浄であることを明確にするため ②ウエハーには、表面のみならず、裏面加工もあるので、区別を明確にするため ③改質される工程を明確にするため</p>	<p>御指摘の品目については軍事転用のおそれがあると考えており、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。</p>
33	<p>該当箇所：第6条第17号レ(9) 現行記載案：[有機金属化合物を用いてバリアー膜又はライナーを選択的に成膜するように設計した原子層堆積装置] 文言修正案：下地の導電体との金属ピア接合面（interface）にバリアー膜がない状態で下地の導電体へのコンタクトに金属を充填することを可能にする、有機金属化合物を用いて金属窒化物バリアー膜又はライナーを選択的に成膜するように設計された原子層堆積装置 論拠：現状の改正案の文言は非常に範囲が広く、具体性に欠ける。これでは、仕様が特定されていない装置や用途まで規制することになってしまう。</p> <p>該当箇所：第6条第17号ラ 現行記載案：400度超650度未満の温度で成膜する装置又はウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜する装置であって、次の全てに該当するシリコン及び炭素を含む膜を形成するように設計したもの (1) 5.3 未満の比誘電率のもの (2) 水平方向の開口部の寸法が70 ナノメートル未満のパターンにおいて当該寸法に対する深さの比率が5倍を超えるもの (3) パターンのピッチが100 ナノメートル未満の構造のもの</p> <p>文言修正案：ウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜する装置であって、次の全てに該当するシリコン及び炭素を含む膜を形成するように設計したもの (1) 5.3 未満の比誘電率のもの (2) 水平方向の開口部の寸法が70 ナノメートル未満で、アスペクト比が5:1 を超えるもの (3) パターンのピッチが100ナノメートル未満の構造のもの</p> <p>論拠： 1- 温度範囲の要件しか規定しない場合には、中国及び韓国を含め、外国においても容易に入手可能な多くの仕様が特定されていない成膜装置（例：PEALD シリコン酸化膜 [形成装置]）も対象となってしまう。 2- (2)については、実際にはアスペクト比が5:1 未満となる状態が規定されており、これでは貴省が意図する成果を得られない。</p> <p>該当箇所：第6条第17号中 現行記載案：厚さが100 ナノメートル超であり、かつ、応力が450 メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜するように設計した装置 文言修正案：厚さが100 ナノメートル超であり、かつ、応力が450 メガパスカル未満の平面状のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜するように設計した装置 論拠：「平面状の」という語を挿入しなければ、広範な技術であるカーボンギャップフィルも対象に含まれる。また、広範でどこにでもあるスピノオン技術さえも対象に含まれる。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。また、貨物等省令第6条第17号マにおいて、ウとの重複関係を排除する規定を設けます。</p>

	<p>該当箇所：第6条第17号オ 現行記載案：金属配線間の隙間（幅が25ナノメートル未満であり、かつ、深さが50 ナノメートル超のものに限る。）に比誘電率が3.3未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置 文言修正案：25 ナノメートル未満の、1:1以上のアスペクト比の金属配線間の隙間に比誘電率が3.3未満の低(low-k)誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置 論拠：現状の文言の問題点は、例えば、幅が20 ナノメートルで深さが40 ナノメートルという先進的な構造が規制対象外になってしまうことである。これでは、意図した通りの規制を行うことができない。</p> <p>該当箇所：第6条第17号マ 現行記載案：複数のチャンバー又はステーションを有する装置であって、ドライブプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライブプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの 文言修正案：複数のチャンバー又は複数のステーションを有する除去及び洗浄装置であって、ドライブプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライブプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの。但し、前洗浄機能を有する成膜装置は明示的に除外されるものとする。 論拠：前洗浄又は前加熱機能のある成膜装置をこの規制の対象とすべきではないことを明確にしなければならない。例えば、前処理の洗浄を行うエビタキシャル用に設計した装置は、第6条第17号ウにおいて既に対象とされている。この規定の書きぶりでは、多数の仕様が特定されていない成膜装置が規制の対象となるが、それは意図されていない。</p>	
34	<p>第六条十七のフ 「極紫外線を用いて集積回路を製造するための装置用マスクブランクスまたは当該装置用のパターン付きのマスクを検査するように設計した装置。」の定義を明確化していただきたい。 1.対象となっているのは欠陥検査装置という理解でよろしいでしょうか？ 2.対象となる機種の特性については、「「極紫外線より長波長を用いた露光装置」用のマスクブランクスもしくはパターン付きマスクのための検査」にはない、「極紫外線を用いて集積回路を製造するための装置用マスクブランクスまたは当該装置用のパターン付きのマスクの検査」に特有の感度的（検出サイズ・検出種類など）要求を満たす・もしくはこれを超えることを意図して設計された機種を指す、という理解でよろしいでしょうか？</p>	<p>御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。貨物等省令第6条第17号フについては、極端紫外を用いた半導体製造装置用のマスクブランクス又はパターン付きマスクの検査を行う意図を持って設計された装置が対象となります。</p>
35	<p>近年、世界における軍事紛争や地政学的リスクが激化する中、世界の平和と地域の安定を維持するために、輸出規制の必要性が高まっている。当方でも大規模破壊兵器の拡散を防ぎ、軍事的安全保障を守るために日本政府が導入した輸出管理措置に対し十分に理解している。しかし、今回の改正内容は、多くの民生用機器を巻き込み、影響範囲が広いだけでなく、より中国をターゲットにしたものだと感じている。これを踏まえて、以下の意見を提言したいと思う。</p> <p>一、本改定案は中国と日本の半導体産業の発展に影響を与えること 本改定案は、貴国が大きな優位性を持つ半導体（チップ）装置の供給領域に焦点を当てたものであり、日中両国の半導体産業の発展に大きなマイナスの影響を与えていくと感じている。半導体産業は高度にグローバル化した産業であり、世界のどの国でも一カ国単独でハイグレードチップの生産・製造の全容を完全に把握できていない状況である。半導体産業の発展は、大規模なグローバルネットワークに支えられており、日本・米国・韓国・欧州などの国/地域の協力が必要であり、また世界の半導体産業チェーンやサプライチェーンの円滑な運営を維持するためには、中国の緊密な協力が必要と思われる。中国と日本は、半導体分野で互恵的でウィンウィンの状況を形成している。中国は日本の半導体製造装置メーカーにとって第一の輸出先であり、2022年、日本から中国への半導体製造装置の輸出額は輸出総額の30%を占める8200億円以上に達している。東京エレクトロニクスは収益の約28%、エデルマンは収益の約25%が中国との取引からとなっている。現在、全世界の半導体市場での需要が下がっている中で、本改定案は、短期的に貴国の装置メーカーに直接影響を与え、貴国の市場開拓の利益を著しく損ない、世界の半導体サプライチェーンシステムの混乱をきたすこととなるとと思われる。技術発展と経済的な安定性を維持するためには、幅広い市場応用と多様なパートナーに支えられる必要がある。日中両国は全世界半導体産業発展の中で利益が統一していると思われ、当方としては安定した経済発展と安全リスク回避の間にバランスをとり、本改定案を慎重に行使されることを希望するものである。</p> <p>二、本改定案は輸出管理本来の目的である "不拡散" を失わせるものであること 輸出管理制度の主な目的の一つは、国際的な不拡散プロセスを効果的に促進し、国際的な平和と安全を維持することである。また、貴国も今回の意見公募において、この改正の目的が特定の物品および技術の「軍事利用」を防止することであると述べている。しかし、本改定案は幅広い品目を対象としており、その中には多くものは家電製品の製造が最終用途となるものであり、軍事的な関連はない。このような規制品目の範囲の拡大は、「不拡散」の目的から逸脱し、正常な国際貿易や経済協力を阻害することになることを懸念している。例えば、本改定案の第5条、第12条、第20条では、半導体製造装置の幅広い用途を対象としており、実質的に90nm～28nmのような成熟した製造を過剰に規制しており、規制対象品目は軍事的な性質を持たない。広く使用されている非軍事品が規制対象に含まれることで、規制対象企業は非軍事品が正常に輸出できなくなり、今後の国際貿易に明らかな悪影響を与え、国際的な不拡散義務の履行にもメリットをもたらさないとと思われる。管理品目リストの改定に当たり、当方は国際的な不拡散義務を考慮し、管理品目の範囲を合理的に定義し、非軍事品目の過剰な管理を防止し、輸出管理措置の乱用や正常な貿易活動や科学技術協力の妨げにならないようにすることを期待するものである。</p> <p>三、本改定案は半導体の輸出規制の範囲を過度に拡大するものであること 輸出管理制度は、国際的な平和と安全を維持するために必要なものであり、国際協力を円滑に進めるために国際通用規則との一致性が必要である。そういった国際通用規則からの逸脱は、企業の日常国際貿易や経済活動に不必要な支障をもたらし、産業の健全な発展に影響を及ぼす。当方は本改定案で管理される項目が、国際通用規則上の管理項目の範囲を超えていることを懸念している。その一方、今回増加された管理品目は国際輸出管理規制品目リストに入らなかったものも含まれている。2014年、ワッセナー・アレンジメントは、管理品目リストにおけるリソグラフィ関連品目の技術仕様を調整し、関連するDUVリソグラフィを管理品目リストから削除したが、これはワッセナー・アレンジメント加盟国の共同決定によるものである。しかし、9年の歳月を経て、貴国は本改定案ですべての液浸式DUVの輸出を制限しようとしており、ワッセナー・アレンジメントの輸出管理リストと矛盾している。一方、本改定案で貴国が新たにリストアップしたものは、米国やオランダのものよりも幅広いものである。2022年10月に米国が新規輸出管理に11種類の蒸着装置をリストアップしたが、今回は上記の11種類の蒸着装置に加えて、リソグラフィ・エッチング・熱処理・洗浄・テスト用の各装置を大量にリストアップしようとしているが、これは米国のリスト範囲を超えているものである。第2項の改定案を例にとると、第2項ではNA>1.07のリソグラフィ装置が全て制限され、ArF液浸リソグラフィもNAが1.35のものも一律制限しようとしている。ワッセナー・アレンジメントではDUVリソグラフィを輸出管理リストから明確に除外し、米国やオランダの最新の輸出管理規則でもArF液浸リソグラフィ全てを包括的に管理していないことから、今回の貴国の管理対象はより広い範囲であることがわかる。当方として輸出管理法を改正する際には、現行の国際輸出管理規則との相乗効果や整合性を十分に考慮し、管理品目の範囲が過度に拡大され、企業の正常な経済・貿易活動が妨げられ、産業の正常な発展に害を及ぼすことがないように配慮することを期待している。</p> <p>四、本改定案はあまりにも短期間で行われたこと 本改定案の執行日は、あまりにも給だと思われる。一方、今回発表された輸出管理措置は、広い範囲の製品と複雑な技術仕様を含むが、意見公募期間は措置の発表日からわずか30日であり、貴国の行政手続法における公告期間の下限という原則要件をかるうじて満たしている状況である。一方、本措置は4月29日の意見公募期間終了後、5月に正式発表され、7月に導入・実施される予定となっており、時間間隔が非常に短いものと感じられる。政府部門が各方面からの意見を適切に収集し、評価、取り入れ、それに応じた措置の内容や規定を適切に修正することは困難であるのではないかと懸念している。また、本改定案は専門性の高い分野であり、貴国の行政機関の情報公開の伝統に則り、日本企業、在日外国企業、貿易関連企業、その他の一般市民の理解を得るために、本法案の根拠、背景情報、本法案の実務上の影響に関する分析などの本法案に関する資料を十分に開示すべきである。それにより、意見公募の有効性を高めることができると考えている。当方としては企業や国民の実際の利益を守るため、「適正プロセス」の原則に十分配慮し、意見公募の時間を延長し、より幅広く意見を募集し、合理的な意見を効果的に取り入れられることを希望している。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、御指摘のように特定の国を念頭に置くものではなく、国際ルールに整合的に実施するものです。また、従前の改正と同様、法令に基づくパブリックコメント期間を設定しているほか、公布から施行まで2カ月の周知期間を置くことを予定しています。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
	<p>・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 本意見には、以下の三つの部分があります。 第一に、「意見公募の趣旨・目的・背景」についてです。世界貿易機関規則、RCEP 地域の経済貿易規則とは、初期的に不一致があります。 第二に、「意見公募の趣旨・目的・背景」についてです。国家安全保障上の例外の拡大適用は、国際経済貿易法に悪影響を及ぼす可能性があります。 第三に、措置そのものが日本及び中日の経済貿易関係にもたらす可能性のある悪影響についてです。 ・意見内容 第一に、『意見公募』の「1.意見公募の趣旨・目的・背景」には、改正の趣旨と目的に関する説明があります。世界貿易機関（WTO）の既存の事例から見ますと、WTO の既存の判例はGATT 第21 条の安全保障例外の適用を厳しく定義しています。日本側の措置の趣旨と目的と、既存の規則や判例とは現時点では一致していないようです。 第二に、「意見募集」では、「1.意見公募の趣旨・目的・背景」で提出された改正の趣旨及び目的と、中日が共同で参加した地域貿易協定RCEP の下で安全保障上の例外が認められ得る状況とは、初期的に矛盾しているようです。 第三に、「意見募集」では、「1.意見公募の趣旨・目的・背景」によりますと、輸出管理措置を講じるうえで動案する要因として、軍事転用の防止や関係国の輸出管理動向などが挙げられます。その結果、国家安全の理由で貿易規制措置の適用範囲を過度に拡張し、国際経済貿易法に悪影響を及ぼします。 第四に、世界貿易機関とRCEP などの地域貿易規則は、国際貿易の基本的な規範を定めている。一国が国家安全保障上の理由で貿易制限を拡大しますと、他国もそのまねをすることでしよう。日本は貿易大国であり、貿易立国の国でもあります。今回のことが中日経済貿易関係に与える悪影響について十分に予測することです。中日両国が世界貿易機関やRCEP などをもとに、積極的に二国間の交渉を通じて協議し、問題を解決することを提案します。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、特定の国を念頭に置くものではなく、国際ルールに整合的に実施するものです。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

36	<p>・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。）</p> <p>第一に、『意見公募』の「1.意見公募の趣旨・目的・背景」には、改正の趣旨と目的に関する説明があります。世界貿易機関（WTO）の既存の事例から見ますと、WTOの既存の判例はGATT第21条の安全保障例外の適用を厳しく定義しています。日本側の措置の趣旨と目的と、既存の規則や判例とは初期的に一致していないようです。</p> <p>『意見公募』の「1.意見公募の趣旨、目的と背景（1.意見公募の趣旨・目的・背景）」の中で次の内容が記載されています。具体的に：「国際的な安全保障環境が厳しさを増すなか、軍事転用の防止を目的として、ワッセナーアレンジメントを補完するとともに、半導体製造装置に関する関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案し、特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加することとしました。このため、対象となる貨物及び技術の仕様等を追加する改正を行うとともに、所要の手続等を定めることとします。」</p> <p>確かに、世界貿易機関（WTO）の関連規則、特にGATT 1944 第21条（安全保障のための例外）に基づいて、第11条（数量制限の一般廃止）との義務を免れるために、WTO加盟国は特定の条件下で輸出入に禁止または制限要件を課すことが認められています。【Appellate Body Reports, Argentina – Import Measures, para. 5.220. [“certain provisions of the GATT 1994, such as Articles XII, XIV, XV, XVIII, XX, and XXI, permit a Member, in certain specified circumstances, to be excused from its obligations under Article XI:1.”]】しかし、第21条規則自体と既存のWTO判決事例からみると、GATT 1944の第21条（安全保障のための例外）の適用は、単なる自己主張・自己声明や自己判断するものではなく、関係の条件を満たす必要があります。</p> <p>第21(b)条を適用する前提について、専門家パネルは、アメリカ-鉄鋼およびアルミニウム製品（トルコ）の事案において、アメリカ側が提出された第21(b)条が自己判断条項（self-judging nature）または専門家パネルによる司法判断不適合（non-justiciability）との主張は棄却されました。また、第21(b)条の各条項（subparagraphs）について、当該条項を援用する加盟国の自己判断に完全に委ねることも認められていません。（wholly reserves the subparagraphs to the judgment of the invoking Member）。【Panel Report, US – Steel and Aluminium Products (Turkey), para. 7.143. “The Panel does not consider that Article XXI(b) of the GATT 1994 is ‘self-judging’ or ‘nonjusticiable’ in the sense argued by the United States, nor that the provision contains a ‘single relative clause’ that wholly reserves the conditions and circumstances of the subparagraphs to the judgment of the invoking Member.”】</p> <p>また、専門家パネルは、アメリカ-原産地表示（中国香港）事案において、次の判決を下しました。具体的に：第21(b)条の「which it considers」の範囲が「essential security interests」のみを含み、その各項までカバーしません。つまり、各項の役割として、加盟国が基本的安全保障上の利益を保護するために、この条項を援用して必要とされている措置（第21(b)条chapeau）を講ずることを制限（circumscribe and limit）するとのことです。すなわち、第21(b)条について、援用国は部分的に自己判断（partly self-judging）しかできません。【Panel Report, US – Origin Marking (Hong Kong, China), paras. 7.88-7.89. [“Having examined the structure of the text of Article XXI(b) in all three authentic languages, we have discerned a clear meaning, namely that the phrase ‘which it considers’ does not extend to the subparagraphs.”]】さらに、専門家パネルは、ロシア-通過運送事案の判決によると、各加盟国が基本的安全保障上の利益を決定する権利を持っていますが、しかし、そのような自由裁量権利は無制限ではありません。代わりに、加盟国が自国の基本的安全保障上の利益に関する定義や解釈は、善意の原則（good faith）によって制限されるべきです。【Panel Report, Russia – Traffic in Transit, paras. 7.131-7.132. [“However, this does not mean that a Member is free to elevate any concern to that of an ‘essential security interest’. Rather, the discretion of a Member to designate particular concerns as ‘essential security interests’ is limited by its obligation to interpret and apply Article XXI(b)(iii) of the GATT 1994 in good faith.”]】</p> <p>事実上、「基本的安全保障上の利益」は「安全保障上の利益」よりも狭い概念であり、一般には、国家の基本的な機能（quintessential functions）（すなわち、その国の領土と国民を外部からの脅威から保護し、国内法と公的秩序を維持すること）に関する利益として理解することができます。【Panel Report, Russia – Traffic in Transit, para. 7.76. [“An emergency in international relations would, therefore, appear to refer generally to a situation of armed conflict, or of latent armed conflict, or of heightened tension or crisis, or of general instability engulfing or surrounding a state.4Such situations give rise to particular types of interests for the Member in question, i.e. defence or military interests, or maintenance of law and public order interests.”]】その基本的な安全保障上の利益は、国際関係における緊急事態のある場合に限って発生します。すなわち、武力紛争または武力紛争の可能性（armed conflict）、緊張情勢または危機エスカレート（heightened tension or crisis）、加盟国の全般的な不安定性（general instability）がある場合に、加盟国で発生する国防や軍事的利益の保護および法律や公的秩序の維持における特定利益とのことです。【Panel Report, Russia – Traffic in Transit, para. 7.76. [“An emergency in international relations would, therefore, appear to refer generally to a situation of armed conflict, or of latent armed conflict, or of heightened tension or crisis, or of general instability engulfing or surrounding a state.4Such situations give rise to particular types of interests for the Member in question, i.e. defence or military interests, or maintenance of law and public order interests.”]】加盟国間の政治的および経済的相違は、国防および軍事的利益（defence or military interests）、法律および公的秩序の維持における利益（maintenance of law and public order interests）を生じさせない限り、国際関係における緊急事態とみなすことはできません。【Panel Report, Russia – Traffic in Transit, para. 7.76. [“An emergency in international relations would, therefore, appear to refer generally to a situation of armed conflict, or of latent armed conflict, or of heightened tension or crisis, or of general instability engulfing or surrounding a state.4Such situations give rise to particular types of interests for the Member in question, i.e. defence or military interests, or maintenance of law and public order interests.”]】</p> <p>『意見公募』の「1.意見公募の趣旨・目的・背景」の中で、「国際的な安全保障環境が厳しさを増すなか、軍事転用の防止を目的として、ワッセナーアレンジメントを補完するとともに、半導体製造装置に関する関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案し、特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加することとしました。このため、対象となる貨物及び技術の仕様等を追加する改正を行うとともに、所要の手続等を定めることとします。」と指摘されています。前述の部分とWTO第21条の関連条項や既存判例と照らし合わせると、相違が多いように見えます。『意見公募』の中で、半導体分野の競争において、GATT 1994 第21条が維持されているWTO法律の権利義務のバランスを崩すような対策を講じなければいけないとの事態を招いた国際関係情勢の深刻さおよび緊迫性について、特に言及せず、客観的な証拠も提供されていません。『意見公募』の措置は日本がWTO条項における義務と相違するかどうかを日本政府に慎重に検討して頂きたいです。</p>	
	<p>第二に、『意見公募』「1.意見公募の趣旨・目的・背景」に指摘された改訂趣旨と目的について、中日両国が共に参加した地域貿易協定（例えばRCEP等）の条項における国家安全面の理由で得られる条項遵守の免除との状況とは一致していないように思われます。中日両国が共に加盟し、発効した『地域的な包括的経済連携協定』（RCEP）の第17章（一般規定及び例外）第13条（安全保障のための例外）において、RCEP加盟国に対し、国家安全を理由に制限措置を講じることが規定されています。第13条はGATT 1994の第21条に基づき、適宜に展開したもので、核心の要素としては一致しています。現在、RCEP条項に、第13条（安全保障のための例外）に関する事案や判例がないものの、第13条がGATT 1994の第21条と類似性と関連性を有するため、GATT 1994の第21条の適用および解釈に関する内容は、第13条における義務を理解するうえで、参考する意義があります。『意見公募』の措置は、日本がRCEP条項における中国を含んだその他の加盟国の義務との一致性問題について、日本政府に慎重に考慮して頂きたいです。</p>	
	<p>第三に、『意見公募』の「1.意見公募の趣旨・目的・背景」では、輸出管理措置を講じるうえで勘案する要因として、軍事転用の防止や関係国の輸出管理動向などが挙げられます。その結果、国家安全の理由で貿易規制措置の適用範囲を拡張し、国際的な経済貿易法に悪影響を及ぼす恐れがあります。</p> <p>「1.意見公募の趣旨・目的・背景」によると、今回の日本の措置は、新たに追加された輸出管理の対象の軍事転用の「防止」を目的としています。このような予防的措置から、新しい輸出管理の対象は現在、まだ軍事に使われておらず、国際関係の緊急事態が発生する前に、国家の安全利益を守るための対策を事前に講じ、明らかに第21条の（b）（iii）の時間要件を満たしていないと言えます。さらに、この措置によって、客観的に、どのような製品でも輸出管理の適用範囲に入り、「軍事転用の防止」という主張で正当化されるかもしれません。このような理由で「例外」に適用するという手段によって、GATT1994第21条の国家安全保障のための例外なら、あらゆる製品に制限なく適用でき、WTOメンバーに重大な法律リスクをもたらし、全世界の産業チェーン・サプライチェーンの安定性と国際経済貿易関係により大きな不確かさをもたらします。また、「1.意見公募の趣旨・目的・背景」では、「半導体製造装置に関する関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案する」という記述から、他国の国家安全利益に対する判断をもって、日本自らの国家安全利益に対する判断の「代わり」をするようで、一般国際法の【Panel Report, Russia – Traffic in Transit, para. 7.132. [“The Panel recalls that the obligation of good faith is a general principle of law and a principle of general international law which underlies all treaties, as codified in Article 31(1) (‘a treaty shall be interpreted in good faith …’) and Article 26 (‘every treaty … must be performed by the parties in good faith’) of the Vienna Convention.”]】という原則に反するのみならず、各国が自主的に自国の貿易を管理すべきだという規定に違反しています。これにより、国家安全の理由で、貿易規制措置の適用範囲を拡張し、国際経済貿易法に悪影響を与える可能性があります。</p>	
	<p>第四に、世界貿易機関やRCEPなどの地域貿易規則により、国際貿易のために基本的な規範が定められています。一国が国家安全の理由で貿易規制措置の適用範囲を拡張したら、他の国も必ず倣うことになります。日本は貿易大国であり、貿易立国とも言われています。今回のことが中日両国の経済貿易関係に与える悪影響に耐えられるか否かを十分に予測する必要があります。中日両国が世界貿易機関やRCEPなどをもとに、両国間のルートで積極的に協議することで、問題を解決すべきだと思います。規則に基づく貿易体制は各方面にとって有利なものです。国際貿易関係の法治化と安定化は、対外貿易に強く依存している国にさらに有利です。一国が国家安全の理由で貿易規制措置の適用範囲を拡張したら、他の国も必ず倣うことになります。それで国際貿易問題の政治化も広く見られ、対外貿易に強く依存している国に最も大きな影響を及ぼします。以前、日本が韓国に対して輸出管理措置を講じたことを受け、韓国も対抗措置を講じ、両国の経済貿易関係に変動をもたらしました。『意見公募』の措置が中日両国の経済貿易関係に対する悪影響に耐えられるか否かを十分に予測する必要があります。もし両国がお互いに貿易規制措置を講じれば、中日両国はダメージを受けますが、第三者はメリットを受けることになるでしょう。中日両国の政府が世界貿易機関やRCEPなどをもとに、両国間のルートで積極的に協議することで妥当な解決策を見つけて出すことによって、合理的かつ有効な輸出管理を実現するとともに、双方の経済貿易協力を確保し、ともに経済貿易法を守るべきだと考えられます。</p>	
37	<p>貨物等省令第6条第17号マについて 意見 汚染物に関して「レジストは含まない」と注記していただきたい。 理由 規制対象となる装置を明確化するため。</p> <p>貨物等省令第6条第17号ケについて 意見 表面改質に関して「異物又は金属等の汚染物質の除去は含まない」と注記していただきたい。 理由 規制対象となる装置を明確化するため。</p> <p>対面での相談窓口設置 要望 今回の措置に関しては、運用面で不明な点が出てくるのが予想されますので、対面での相談窓口を設置していただきたい。</p>	<p>御指摘の品目については軍事転用のおそれがあると考えており、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

38	<p>該当箇所：改正案17号全文（詳細は本文をご参照ください）</p> <p>意見内容：日本政府が3月31日発表した半導体製造装置23品目を輸出管理に追加する省令改正案は既存の中国と日本企業間の協力を妨害・破壊し、または不確実性を増大するものであり、中国企業にとって、日本からの製品調達・日本技術の利用が妨げられることとなります。必要な範囲から逸脱し、軍事と関係のない民生用の品目を対象としたかかる改正案は現行の輸出管理の考えと国際アレンジメントと整合せず、WTOルールにも反しています。</p> <p>この省令改正案に対し、当会のコメントは以下のとおりです。</p> <p>1.今次の改正案では、規制対象が広範囲に及び、国際社会で一般的に認められている品目リストを遥かに明らかに上回り、ワッセナー・アレンジメントから逸脱しているため、関係企業は非常に困っています。ワッセナー・アレンジメントと同じアイテムをしていただくことを提案します。</p> <p>2.23品目にのぼる今次の改正案は軍事用途の半導体生産装置を規制することを大義名分としていますが、実質的にはArF液浸露光装置、半導体エッチング装置、洗浄装置等明らかに民生用に使用されるものも対象に入れています。これは中国の半導体企業の正当な利益を損なうだけでなく、日本の半導体装置メーカーの正当な利益をも損ない、自由貿易の原則に反するものであります。今次の措置により、従来ある成熟した製造プロセスのサプライチェーンに陰りを落とす恐れがあるため、措置の拡大化防止の観点から、対象品目数を減らし、関係企業のコンプライアンス面の負担と発生しうるさらなる悪影響を軽減すべきです。半導体サプライチェーンへの影響が増大し、ビジネスが不必要に中断することのないよう、日本政府に対し、対象範囲の縮小、当該輸出管理措置に関わる具体的品番の明確化を強く提案します。</p> <p>3.改正案17号のヲについて。ArF液浸露光装置が28/40/55nm等の成熟ノードに使用されていることから、この条目を削除するか、またはワッセナー・アレンジメントと整合するよう、K値を0.35に見直すことを提案します。</p> <p>4.同17号のワについて。EUVプロセスにも、DUVプロセスにも使える装置があるため、「EUVにのみ使用される半導体製造装置」に修正することを提案します。</p> <p>5.同17号のカについて。規制範囲が広すぎる。一部のパラメーターの見直しを提案します。例えばカの二の2の「切替時間300ミリ秒未満」を「切替時間100ミリ秒未満」に修正すべきです</p> <p>6.同17号のヨからナまでの内容について。中に含まれる多くの装置はメモリチップの製造にも使用され、しかも大多数が成熟プロセスに該当するため、削除することを提案します。もし削除できなければ、少なくとも「10nm以下の先端プロセスにのみ使用されるもの」に制限すべきです。</p> <p>7.同17号のラについて。対象装置はメモリプロセスや28nm等の成熟ロジックプロセスに広く使用されているため、削除することを提案します。もし削除できなければ、少なくとも「10nm以下の先端プロセスにのみ使用されるもの」に制限すべきです。</p> <p>8.同17号のウからヤまでの内容について。削除することを提案します。もし削除できなければ、少なくとも「10nm以下の先端プロセスにのみ使用されるもの」に制限すべきです。</p> <p>9.同17号のマとケについて。対象装置が28nm等の成熟ノードに広く使用されているため、当該管理措置は成熟プロセスを過度に規制することとなります。削除することを提案します。もし削除できなければ、少なくとも「10nm以下の先端プロセスにのみ使用されるもの」に制限すべきです。</p> <p>10.同17号のフについて。規制範囲が広がらないように「～製造するための装置用～」を「～製造するための装置のみに使用される～」に修正することを提案します。</p> <p>11.既に成立した中国企業の注文(確認済みの基本契約を含む)については、日本の半導体装置メーカーが契約を履行し、確実に納入することは保証されなければなりません。</p> <p>12.中国企業に納入された半導体装置については、日本の半導体装置メーカーが契約を履行し、通常の修理、メンテナンス、チューニング、スペアパーツサービスを提供することは保証されなければなりません。</p> <p>13.今次の措置により、日本の関係企業は大きな被害を蒙り、売上の減少に加え、次世代装置の開発や技術の進化を支える原資となる利益が十分に確保できないため、国際市場における日本企業の競争力の低下に繋がります。</p> <p>14.歴史を振り返ると、日本は半導体の分野で世界に大きな貢献をしてきました。一方、中国の半導体市場は、ポテンシャルが極めて大きいだけでなく、新しい応用場面も次々と提案され、両国の半導体産業の連携協力が大きな可能性をもたらしています。日本政府は、日本の半導体企業が中国の半導体産業の発展に積極的かつ継続的に関与することを支援することを望みます。このような関与は日本の優位性の維持、産業の持続成長につながるると同時に、日本の半導体産業に再興のチャンスをもたらします。</p> <p>15.長年来、日本の産業界と非常に円滑な交流・連携を行ってきました。今次の規制措置が、日本の産業界の今後のビジネス戦略に大きな不確実性をもたらすと両国の半導体業界は受け止めており、日本政府が将来の発展に着眼し、両国の半導体業界の良好な信頼・連携関係と極めて大きい協力の可能性が壊されないように配慮いただくことを希望します。</p> <p>16.一貫して両国半導体産業の連携協力の促進に取り組み、様々な場を利用して次の考えを発信しています。まず、中国政府と業界はオープンな協力を堅持し、海外のあらゆる半導体企業の中国進出・対中投資を歓迎します。また、中国の市場ニーズが極めて大きく、半導体産業は今後も成長し続けて、深いつながりを持つ両国の半導体産業はこの成長の果実を分かち合うことができます。最後に、日本の半導体業界、関係団体が中国の半導体産業界と意思疎通し、半導体業界の国際協力を共に推し進め、グローバルサプライチェーンの安定維持に共に貢献して行くことを歓迎します。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、国際ルールに整合的に実施するものです。このため、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
39	<p>該当箇所：「包括許可取扱要領」別表B 今回規制に追加された貨物等省令第6条第17号ルからフまで又は第17号の2のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術に対する特別一般包括役務取引許可の対象となる提供地に関して</p> <p>貨物、使用のために設計したプログラムと異なり、提供地が「い地域」、「と地域②」、「り地域」の場合も特別一般包括役務取引許可の対象になっていません。上記の地域も貨物等と同じく特別一般包括役務取引許可の対象にできないでしょうか？もしできないとすれば、その理由を説明願います。また、今後、本件も含め他国における運用も参考にして整合のとれた規制になるよう見直し頂くことを要望致します。</p> <p>理由：</p> <p>特別一般包括許可の対象となる提供地域が貨物などと異なるのは不自然と感じます。また、「国際的な安全保障環境が厳しさを増すなかでの軍事転用の防止」が目的であれば、これらの地域(特に「い地域」)における提供の制限が必要か疑問を感じます。今後、改正案に当たる法令を既に運用をしている国、また今後運用を開始する国の動向に着目し、随時、整合性のとれた形に改正して頂き、日本企業だけがビジネス面で不利にならないようご配慮をお願いするものです。尚、参考ですが、EAR(米国輸出管理規則)において、ECCN(輸出管理分類番号)3B090で貨物等省令第6条第十七号レ(今回追加)に相当する品目が規制されていますが、3B090品目の設計(開発)、製造の技術(ECCN：3E001)の規制理由はAT1とRS(特定の国向け)で、「い地域」、「と地域②」、「り地域」に相当する提供国の場合、許可不要の扱いになっています。</p> <p>該当箇所：貨物等省令第6条第十七号カ(二)2の「切替時間」に関して</p> <p>「切替時間が300ミリ秒未満の高速ガス切替弁」における切替時間の定義(測定条件)を運用通達若しくはQ&A等で明確にして頂きたい。</p> <p>理由：切替時間は、弁の作動方法等により大きく異なります。切替時間はカタログに記載されていない場合もありますが、弁のユーザーには測定/評価が難しく、該非判定のためには、メーカーに測定をして頂く必要があります。しかし、そのためには、測定条件を決める必要があり、明確にして頂きたいものです。</p> <p>該当箇所：輸出令別表第一の七の項十七号 フ「極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスクブランク又は当該装置用のパターン付きのマスクを検査するように設計した装置」</p> <p>もともと通常のウエハーを検査する目的で設計された検査装置ではあるが、極端紫外用のマスクを検査できるよう、ウェーハステージと搬送系を改造、ロードポートをマスク専用のもにに変更した検査装置は該当となるかどうか不明確。当該装置の主要な要素は他の目的でも使用できる場合は非該当であれば明示していただきたい。</p>	<p>包括許可制度の適用に係る仕向地については、安全保障上の観点から総合的に判断しているものです。御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。</p>
40	<p>【該当箇所】</p> <p>貨物等省令第6条第十七号 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品</p> <p>7項の解釈（運用通達 1-1（7）イ 「輸出令別表第1の解釈」）</p> <p>輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定める仕様のもの</p> <p>貨物等省令第6条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二までに該当するものであって輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するよう特別に設計したもの又はこれと同じ機能特性のものは、輸出令別表第1の当該貨物の規定に基づいて判定するものとする。</p> <p>【意見内容】</p> <p>次のとおり修正する</p> <p>輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定める仕様のもの</p> <p>「貨物等省令第6条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二までに該当するものであって」の部分</p> <p>「貨物等省令第6条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十七号までに該当するものであって」に変更する。</p> <p>【理由】</p> <p>現行の7項の解釈では「貨物等省令第6条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二までに該当するものであって」となっており、今回の省令第6条第十七号は対象外となります。この場合、例えば既存の補修用該当部品（2項圧力計や3項(2)熱交換器等）が、今回の該当装置の専用部分品でもある場合、元の該当項番に対して7項(16)が重複で適用され、従来保有している項番の特定包括等のライセンスのみでは適用不可となり、新たに個々の許可申請手続きが必要になると思われれます。十七号も対象とすることにより、専用部分品、附属品であっても従来の他項番で既に該当の貨物の場合は、従来通り元の該当項番による規制とライセンスによる対応とするほうが合理的で望ましいと考えます。また参考までに、米国EAR part772 "Specially designed" (b) の項においても、他で規制されている品目の場合は専用部分品の規制ECCNからは除外される旨が記載されているように見受けられます。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
41	<p>今回規制される半導体製造装置の特性・能力・耐性評価等に用いるマスク及びマスクブランクは、半導体製造装置の部分品・付属品として規制されるでしょうか？（マスク及びマスクブランク単体では非該当品です）</p>	<p>御指摘の品目については、今回の措置の対象ではなく、従前通りの扱いとなります。</p>

42	<p>・該当箇所：省令改正案「○経済産業省令第 号」「次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。」から始まる部分につきまして。</p> <p>・意見内容：</p> <p>歴史的に、半導体製造装置産業は自由貿易の恩恵を受けてきた業種であり、半導体産業は世界中から最も優れた技術を持ち寄ることで発展して参りました。現在最先端のロジック半導体に用いられる5nm/4nm技術も、ほとんどがスマートフォン等民生品用途に利用されています。その一方で、先端半導体技術が軍需用途に転用される可能性につきましては、産業界としてもそのリスクを理解しております。今回のパブリックコメント募集については、全地域向けの貨物が対象で、特定の国を念頭に置くものではないと承知しております。軍事転用の恐れがないなら、通常通り輸出が可能となることも、合わせて認識しております。省令改正案に対する意見としては、以下の5点となります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技術的な定義や閾値（しきいち）といったものは極力明確にさせていただきたい。輸出許可申請が必要かどうか判断するにあたって、定義の曖昧さそのものが申請の事務量を増やすため。 2. 半導体製造装置業界向けに、実務的な申請のフォーマット、記入必要事項、内容について、実務者がわかりやすい形で事前説明をお願いしたい。情報共有の場を設けていただきたい。 3. 今後は、輸出許可申請の増加が予想されるため、許可証発行の停滞が起きないように事前の体制確保（人員確保・インフラ）を万全をお願いしたい。 4. 申請があってから許可までの日数を短縮していただきたい。出来れば許可・不許可が判断されるまでの最長日数の上限を設けていただきたい。半導体製造装置の種類によっては受注から出荷までのリードタイムが短い製品も多く、事業活動に支障が出ないよう配慮をお願いしたい。 5. 半導体は技術進化のスピードが早く、今後とも管理強化の妥当性とその範囲を継続的に検討するようお願いしたい。日本以外の半導体製造装置生産国との競争関係で、バランス上不利にならないよう十分な配慮をお願いしたい。 <p>・理由：上記に含みます。</p>	<p>御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
	<p>I. 全般</p> <p>I. 意見：【全般的评价】</p> <p>今回の措置については、以下の点で積極的に評価されるものと考えております。</p> <p>(1) 今回の措置は、産構審小委提言（21年6月）にある「技術を保有し、政策目的を共有する少数の国が参加する枠組み」（以下、「同盟国連携」と呼びます）の提言趣旨に沿った第一歩と思われ、有意義でエボックメイキングなものと思われること。</p> <p>(2) 厳しい国際安全保障情勢の中で、従来よりも踏み込んだ管理規制となっはいるものの、次の点で配慮がなされていると思われること。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 先端半導体用途向け規制として、米国のように管理対象品目を限定しないエンドユース規制での対応ではなく、管理対象を明示したリスト規制となっており、明確性、対応負担の点で優れていること。 ② 管理対象品目を先端半導体用途になり得る品目全般に広げることなく、ある程度チョークポイント的な品目に限定したと思われること。 ③ 全地域向けとしつつも、懸念が少ない42の国・地域には包括許可（一般包括／特別一般包括）の利用を可能とし、韓国、台湾を含めて同盟国・同盟国で構築されつつある半導体サプライチェーン内での供給制約にならないよう配慮していること。 <p>II. 同盟国連携としての実効性、緊密性、円滑性等の確保</p> <p>1. 意見：【要望—同盟国連携の一環であることの明確化】</p> <p>今回の日本の措置は、同盟国連携の一環と理解していますが、趣旨についてのご説明内容と、産構審小委提言で想定している同盟国連携に関する提言内容との間でギャップが感じられ、やや困惑するところがありました。プレス向けのご説明で、「我が国として必要と考える措置」「それぞれの国の判断」とあり、「独自措置」的ニュアンスが感じられました。産構審小委提言では、「極力独自措置によらない形で前述の課題に対応する、新たな機動的な輸出管理の枠組みを我が国のイニシアティブの下、追求していく」「ビジネス上の予見可能性やレベルプレイングフィールドの観点、あるいは実効性の観点で課題がある中、我が国の独自措置の検討については慎重であるべき」というように、「独自措置にはよらない」と強調されていましたし、具体的品目や規制手法等についても協調を図ることが想定されていたように理解していますが、それらの点で乖離があるようにも感じられたところです。残念ながら米国が強力な独自規制を先行して打ち出してしまったために、「米国への追従ではない」ということを強調するための説明がメインになったことによるものと思われませんが、今回の日本の措置は米蘭の理解が得られ、WA合意への反映に連携して取り組んでいくとのことですので、米蘭（更にEU）においても日本と同様の措置がなされる見込みであることを併せてメッセージとして出していたらと、（産構審小委提言にあるような）日本のイニシアティブの下、同盟国連携の一環として行われるものであることが明確になるのではないかと考えられます。</p> <p>2. 意見：【要望—独自措置の回避と、同盟国連携措置の十分な事前調整】</p> <p>G7貿易大臣会合では「効果的かつ責任ある輸出管理を強化するにあたり、他国とともに共に取り組む」との共同声明をとりまとめられたほか、米議会や産業界においても同盟国・同盟国から成る多国間の輸出管理の枠組みの必要性を要請する声が高まっています。最近の厳しい安全保障環境からしても、このような同盟国連携構築に向けた取組みは急がれる必要があると思われまます。今後具体的な検討が進むものと思われまます。具体的な措置を検討する際には、連携内容を連携国間で十分擦り合わせた上で、打ち出すのは同時に行っていただくことを強く要望致します。これは、今回の一連の経過において、本来避けることができたフリクションが生じたことを踏まえたものです。今回の連携措置の契機になったのは、昨年10月7日の米国の対半導体製造・スパコン関連規制ですが、米国が唐突に独自規制として打ち出したことにより、次のような問題が生じたと思ひます。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 米国の措置内容がドラステックなもので、直接製品規制を多用して同盟国等からの輸出も含めて広く適用したことにより、米国が同規制をテコに米国の独自規制への追従を迫るような構図となり、同盟国連携を損なうことになったこと（日蘭ともに、各政府は米国追従ではない旨の説明にエネルギーを費やさざるを得なくなつた）。 ② 米国産業界は米国企業だけが規制を受けることに不満を募らせ、あたかも日蘭企業が規制を受けない中でバックフィル的取引によって市場を奪っているかのような被害者意識を持つような事態も生じていること。強硬姿勢にある米議会の見方もそれに引きずられる懸念があること。 ③ 日本企業含めて同盟国の企業は、米国の複雑なエンドユース規制や直接製品規制への対応を迫られ、そのための手続的、コスト的負担が、（結果的に非該当となったとしても）極めて重いものとなったこと。このような不幸な事態は、ロシア制裁の際のG7での協調対応のように、事前に各国間で十分調整が図り、米国政府としてもそれら同盟国に対しては直接製品規制は適用しないという枠組みを採用していれば、避けることができたと思われまます。G7貿易大臣会合の共同声明での輸出管理に関する合意も、今回のようなフリクションを避けることが念頭にあると理解していますが、産業界にとっても切実な点ですので、ご配慮方お願いいたします。 <p>3. 意見：【要望—日本の措置の他の同盟国・同盟国での早期採用】</p> <p>今回の日本の措置については、「同盟国・同盟国との意見交換を通じて一定の理解を得て、我が国として必要と考える措置を導入するもの」との趣旨のご説明がなされていますが、「それら国々と連携を図りながらワッセナーアレンジメントへの反映も同時並行的に取り組んでいく」旨のご説明もなされています。輸出管理の基本原則であるレベルプレイングフィールドの観点を踏まえると、基本的には同盟国連携による措置内容は共通のものとすることが望ましいところです。日本の措置については、それら同盟国・同盟国においても理解が得られていることから、同様に導入されることが適当と思われまますので、その方向で引き続きご尽力方お願いいたします。なお、G7等の主要国だけでなく、半導体サプライチェーン構成国・地域でも（半導体製造装置が広く流通している等の事情もあり）同様の規制反映がなされることが望ましいと思われまます（香港や韓国メディア等では、日本製中古半導体製造装置に対する問い合わせが急増していると報じられています）。</p> <p>4. 意見：【要望—理解促進のためのより具体的な「厳しさを増している安全保障環境」の発信】</p> <p>今回の措置については、「全地域向けを対象とするものであり、特定の国を対象とするものではない。軍事利用可能性の確保を強化し、厳格な輸出管理を行っていくもの。」「WAの補完」「WAへの反映に取り組む」とし、従来の不拡散型管理の一環として整理されているとのご説明をいただいています。ただ他方で、既存の国際秩序に基づくWAでの合意は、その国際秩序を力で覆したロシアが参加国であることによって難しくなっているわけであり、その現実を前提にして、先端兵器やC4ISRを駆使した軍事力を使って既存の国際秩序に挑戦しようとしている国々を念頭に、同盟国連携による輸出管理強化によって抑止するという流れの中での今回の措置であることは、明らかと思われまます。また、全く想定されなかったロシアによる突然のウクライナ侵攻によって、国際社会はその事後対応のために多大なコスト負担を余儀なくされたことを教訓に、如何に有事の事前抑止を図るかという問題意識の下での対応が図られつつあり、輸出管理での対応もまたそのための重要な手段となってきているとの共通認識も背景にあるものと思われまます。米国はその問題意識を明確に示していますし、オランダもまた、3月8日に、同政府の措置について議会で説明のために提出した書簡の中で、仕向国について直接の言及はなされていないものの、措置理由として、「技術の進歩と地政学的な状況を踏まえ、国家安全保障のため」と説明しているほか、来日した貿易相も、「技術の悪用を防ぐには民主主義国家が協力しなければならない」「日米韓台欧の諸国と話し合ってきた。できるだけ多くの国に規制に参加してもらいたい」とし、西側諸国に連携を呼びかけたと思われまます。上述の問題意識を渗みだしたメッセージを出しています。今後これらの問題意識の下に、同盟国連携による輸出管理の一層の強化も進むでしょうし、従来なかった対外投資規制にまで踏み込み、技術と資金両面での規制に拡大していく流れとなっています。あるいは経済的威圧への対応もまた直近のG7のテーマとなっています。このように地政学的緊張が高まっていく中で、従来の自由貿易体制の中では想定できなかったような新たな次元の規制措置が打ち出されていくであろうことについては、「厳しさが増す安全保障環境」について、産業界、アカデミア、国民に対してより具体的な説明がなされ、新たな規制措置の必要性について理解を求めることが必要になってきていると思われまます。昨年12月に新たな国家安全保障戦略が策定されましたが、「安全保障の対象が経済分野にまで拡大し、安全保障の確保のために経済的手段が一層必要とされている。」と述べられています。このような認識を踏まえて、これらの問題行為の抑止、対抗のための経済的手段としての輸出管理が果たす役割、機能の拡大とその具体的な制度・運用のあり方について、検討がなされる必要があると思われまます。今回の同盟国連携の中での意見交換でもおそらく様々認識の共有が政府間でなされたと思ひまますし、今後の多国間連携の中で議論されていくと思われまます。連携措置について理解を得るためにも、より具体的な「厳しさを増している安全保障環境」の内容について発信についてご検討いただければ幸いです。</p> <p>5. 【要望—既に流通している品目を新たに規制する背景、必要性等の具体的説明】</p> <p>今回の措置の対象品目は、最先端半導体、先端半導体の製造が念頭にあると思われまます。最先端半導体については、「先端」といっても、既に5〜6年近く前の技術であり、製造装置も含めて許可を必要とせず世界の市場に流通しています。その点で、今回の対象品目は、「新興技術」的なものではなく、（既に一定の成熟度があり流通している）「基盤的技術」的品目に属するものであり（米国も以前、半導体製造装置をそのように位置付けていました）、それを管理対象とすることは初めての例としてエボックメイキングなケースになるものと思われまます。関係業界・企業にとっては既存案件への影響も予想され、困惑するところもあると思われまます。「基盤的技術」的品目の追加規制は、半導体分野に限らず今後も出てくる可能性があると思われまます。産業界の理解を深めるためにも、その背景、趣旨より具体的なご説明が望まれるところと思われまます。具体的には、既に一定の成熟段階にある当該品目が、どのような技術的要因によって、どのような懸念される軍事能力の拡大に使われる恐れが現れてきたのか、既存の流通実態がありながらも規制を必要とする安全保障環境の変化は何か、といった点になります。特に、各種半導体やエレクトロニクス関連品目の軍事応用可能性については、経済安全保障の必要性が叫ばれる中、国民、産業界、アカデミア全般において理解を深めることが有益と思われまます。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、スベックにより客観的に範囲を定め、これに該当の装置であれば対象となります。このため、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。</p> <p>貨物等省令第6条第17号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要な不可欠であるか否かになります。</p> <p>EUVヘリクルに関する御質問について、②についてはペリクルはマスクの附属品でありマスクに装着された場合であっても、運用通達の「他の貨物の部分をなしているもの」には当たらない、④については御理解の通りと考えまます。⑤については輸出貿易管理令別表第一の7の項(17)に基づくものですが、法技術的な理由により貨物等省令第6条第17号の2を新設するものです。</p> <p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

<p>III、規制の運用面での配慮について</p> <p>1. 意見：【要望一「軍事用途」判断の困難さに配慮した運用】</p> <p>今回の対象である半導体製造装置は、（工作機械の場合と同様ですが）それ自体が兵器に組み込まれるというのではなく、そこで製造された半導体が軍事用途に使われるのかどうか問題となってきますが、それを輸出企業側に調査を求められるとすれば、それは次のような状況から、困難が大きいと言わざるを得ません。</p> <p>（1）先端半導体製造にもっぱら使われるものであれば、軍事用途利用の懸念が高いということでしょうが、軍事用途といっても、C4ISR的なものを中心になってくると考えられますので、それらの懸念を実際に輸出企業側で見極めるのは困難であること。米国の場合、従来の「軍事用途」とは別途、「（先端）半導体製造用途」という概念を新たに設けて原則禁輸方針としたのも、そのような事情を踏まえたものではないかと想像されることです。</p> <p>（2）中国などでは、輸出管理法、データ安全法等により、「輸出管理情報」（用途、需要者に関する情報等）は「重要データ」として、越境提供は当局の許可・承認対象となっていることや、企業情報もまた海外/外国人によるアクセスが制限されるようになってきていること。</p> <p>このような事情にご理解を賜り、輸出許可申請に係る審査や事前相談等に当たっては、過度に輸出企業に調査負担を求めることなく、輸出管理ご当局の同盟国・同志国との共有情報等を通じて、可否の判断を示していただくようお願いいたします。</p> <p>※C4ISRとは、指揮（Command）、統制（Control）、通信（Communication）、コンピューター（Computer）の4つのCと、情報（Intelligence）、監視（Surveillance）、偵察（Reconnaissance）。</p> <p>2. 意見：【要望一エンドユーザー規制の導入検討】</p> <p>輸出管理の世界では、用途に着目したエンドユース規制と、需要者に着目したエンドユーザー規制とがありますが、明確性、予見可能性、対応負担の観点からは、エンドユーザー規制が優れています。半導体、エレクトロニクス等の分野では、前掲の理由により、それが軍事用途に利用されるかどうかの見極めは難しいものがあります。その点、エンドユーザー規制により、懸念者・禁輸者リストを作成・提示していただければ、リスト規制と相俟って、明確性、予見可能性が担保され、輸出企業の対応負担の観点からも大きなメリットがあります。昨年10月の米国の規制では、先端コンピューティング用IC等やスパコン関連での直接製品規制が導入された中で28企業が対象とされたほか、同年12月のEntity List掲載では、先端半導体製造関連企業も対象となり、直接製品規制対象ともなっています。米国のEntity Listは、「米国の安全保障、外交上の利益を損なう者」ですから、それをそのまま日本で適用することはできないとしても、その中には我が国や国際的平和と安全の観点からも懸念が大きい企業等もあると考えられます。また、同志国の懸念・禁輸者リストを踏まえて、日本企業が輸出しないという場合、相手国からその法令に基づいて問題視される可能性があるという点は以前からお伝えしている通りです。やはり日本政府としての懸念者・禁輸者リストが整備されることにより、日本企業が問題視されたとしても、日本政府の後ろ盾を得られるという点でやはり大きなメリットがあります。また、エレクトロニクス分野を中心に「新興技術」「基盤的技術」関連品目が輸出管理対象として追加されていく場合、詳細なスペックを規定するリスト規制にはなじみにくい面がありますが、その点では、上記のエンドユーザー規制が実効的と考えられます。すぐには難しいとしても、今後、G7貿易大臣会合の共同声明にあるように、G7諸国を中心に同志国による新たな多国間枠組みの検討が進むと考えられますが、その中でエンドユーザーの懸念性についての共通認識を形成しつつ、共通のエンドユーザー規制のご検討をお願いいたします。</p> <p>※なお、外為法では、大量破壊兵器関連の外国ユーザーリストの例がありますし、ロシア制裁に伴う輸出規制の一環として禁輸者リストを整備した例もありますので、現行法の枠内で対処可能で法制的問題は無いと理解しています。</p> <p>3. 意見：【要望一保守部品提供、技術支援等のメンテナンスの扱い】</p> <p>今回の措置で、第6条第十七号では、専用の部分品・附属装置が規制の対象になっています。もし、既輸出分や既契約未納の場合も一律不許可となると、日本企業にも大きな影響が出てくると考えられます（保守部品輸出や技術支援等のメンテナンスの提供困難。状況次第での受注取消等）。既輸出分の場合でも、軍事用途懸念が払拭できなければ許可できないというお考えは理解できますが、オランダにおいても、この既輸出分の保守部品、メンテナンス等の扱いは大きな論点となっていると理解しています。日蘭で同様の扱いになるようオランダ政府等ともよくご調整いただきつつ、個別事案について契約状況その他の事情を踏まえて、適切な対応をお願いいたします。</p> <p>4. 意見【要望一レガシー半導体製造にも使える半導体製造装置の扱い】</p> <p>今回の措置の23品目については、基本的には「先端半導体」以上の高精度のもの製造に関わるものに極力限定しているものの、ローエンドのレガシー半導体の製造にも使われるものも一部にはあると伺っています。スペック上、先端半導体製造に関わるものに限定しきれないということや、レガシー半導体であっても軍事用途に使われる場合には結局はキャッチオール規制対象となるということも理解できるのですが、従来はレガシー半導体は軍事用途懸念は低いということでリスト規制対象でもなく、また、キャッチオール規制でも基本的にはインフォーム要件だけが適用されるに留まっていますから、やはり、リスト規制対象となるというのは、形の上ではかなりの「規制強化」になっていることとなります。このため、先端半導体とレガシー半導体の双方の製造に使える製造装置については、個別事案ごとの状況を十分踏まえて、適切な対応をお願いいたします。</p> <p>5. 意見；【要望一現地の日系企業や同志国企業向けの輸出】</p> <p>現地の日系企業や同志国の現地法人向けの輸出にも適用されることとなりますが、昨年10月の米国の中国向けの半導体製造エンドユース規制では、非懸念国の外資企業向けは「原則禁輸」ではなく、「ケースバイケース」の許可方針とされ、「技術レベル、エンドユーザー、コンプライアンスレベル等の諸要素を考慮する」と示されています。同志国系の中国現地企業への輸出の審査・許可の方針については、ハーモナイズされることが適当と思われるので、同志国間で調整いただき、バランスの取れた運用となるようお願いいたします。</p> <p>6. 【要望一対面でのご相談窓口】</p> <p>今回の措置に関しては、企業側において運用面で不明な点が出てくるのが予想されますので、対面での「相談窓口」を設置していただくことをご検討をお願いします。</p>
<p>IV、同志国連携における米国の直接製品規制の適用免除</p> <p>1. 意見：【要望一同志国連携における米国「直接製品規制」の適用免除一その多大な負担への理解を】</p> <p>先述の通り、米国の対半導体・スパコン関連規制において、直接製品規制が広汎に適用されることとなり、再輸出規制において、デミニミズール以上大きな影響を日本企業にも与えることとなりました。ファーウェイ向けの場合は、ファーウェイとその子会社に限定されておりましたし、ロシア制裁では、日本を含む38か国は、「米国と実質的に類似の規制をコミットしている」ということで適用免除となりました。しかし、昨年10月、12月の対半導体関連規制において、広汎に適用されることとなりました。10月、12月、本年3月の3類型の内の脚注4付Entity List掲載の中国55(28+21+6)組織に係る直接製品規制は、広汎な関連するECCN技術・ソフトウェアから直接製造された品目であれば、限定なく全てが直接製品としてEARの規制対象となり、許可要となります。懸念国に対しては、この直接製品規制は強力な効果を発揮するものであり、域外適用規制だとしてもその役割を否定するものではありませんが、これが我が国を含む同盟国・同志国にまで適用されるとなると、大きな負担となってきます。同規制に照らして、結果的に非該当だったとしても、その判断に至るまでの手続的、経済的負担は決して無視できないものです。規制内容が複雑・難解であり、輸出する品目が、米国製機器・技術・ソフトを使って製造されたものかどうかの判断自体難しいですし、米国当局の日本での相談窓口もない中で、米国法律事務所の助言等を受ける場合に多大なコストが発生します。それは、企業内の限られたマンパワーと予算の中で、通常の輸出管理コストを大きく圧迫するものであり、外為法上の自主管理の的確な遂行にも大きな影響を及ぼすものです。同規制については米議会の超党派のUSCCがその履行状況の詳細な報告を求めているほか、ごく最近、米商務省が直接製品規制違反に対して約3億ドルの罰金を課する事例も現れています。我が国として、直接製品規制の適用を圧力として同調を迫られるという構図になれば問題ですが、それは同志国連携の上でかえって障害となるということについて米政府の理解を求め、認識の共通化を図った上で、ロシア制裁の際と同様に、「実質的に類似の規制」を同志国がタイミングを同じくして行うことによって、直接製品規制の適用は同志国からの輸出に対してはなされないとの連携の基本的枠組みの構築を強く要請するものです。2020年11月に、9団体連名で、米国及び中国の域外適用規制の抑制について要望したところですが、最近の状況を踏まえて、改めて要望させていただき次第です。情勢と切実度合いは当時よりも格段に増していることについても、併せてご理解いただければ幸いです。</p> <p>※9団体連名での要請書 https://www.cistec.or.jp/service/china_law/20201110.pdf</p>
<p>V、同志国連携における規制手法、規制番号体系の国際ハーモナイゼーションの必要性</p> <p>1. 意見：【要望一産構審小委提言に即した品目ごとの規制カテゴリーへの再編に向けた検討】</p> <p>今回の半導体製造装置に係る規制は、輸出貿易管理令別表第一の七の項に対応した貨物等省令の第6条に入れ込む形で手当てされました。</p> <p>他方、長年の懸念として検討が続けられてきている規制番号体系の国際化のための三団体協議会の場での貴省との検討作業の中で、別表第一は、国際輸出管理レジームごとに規制品目が反映されたものであるとの考え方の整理によって、貴省と三団体とが共同で多大な努力をかけた作業が活かされず、当初目的が果たされないうままとなりました。その結果、2017年の産構審小委提言にある「国際レジーム別のカテゴリー構造を、多くの国が採用している品目別の構造に変更することを検討すべき」との提言が実現できなくなったまま現在に至っています（次善の方策を貴省のご尽力で運用に反映していただいたことには感謝しております）。今回、同志国連携に対応した事項を、WA合意事項を反映している輸出令別表第一の七の項に対応した貨物等省令に入れ込むこととされた点については、上述の経緯とは異なりますが、別表第一を品目ごとのカテゴリー構造に組み替える第一歩となるものと理解しております。また、今後も新興技術・基盤的技術に係る品目が同志国連携によって新たに管理対象品目に追加されることがあると思われませんが、それらは別表第一の中で反映されるものと理解いたしました（同志国連携に係る品目は別途の別表に反映する方がわかりやすいとの考え方もありますが、それはレジームごとのカテゴリー構造の延長になりますので、今回の措置を品目ごとの構造に再編する契機とするほうが適切と思われます）。つきましては、新たな考え方の整理を踏まえて、貴省と三団体協議会との協議を再開させていただき、当初目的であった品目別のカテゴリー構造への再編成に向けた検討をお願いいたします。</p> <p>2. 意見：【要望一同志国連携の流れを踏まえた規制手法、規制番号体系等の国際的ハーモナイゼーションの必要性】</p> <p>同志国連携の上では、規制手法や規制番号体系を極力ハーモナイズすることが望まれるところです。今後も、G7 合意、日米協力等を含めて同志国連携に基づいて実施する輸出管理措置も今後も様々出てくるかと思われませんが、日本がそれらの合意に基づいて着実に履行していることが連携相手からも明確に理解しやすいことが望ましいですし、グローバル展開している輸出企業側としても円滑に対応しやすくなります。上述の規制番号体系の再編についても、これまで主として企業のグローバル展開の円滑化、負担軽減の観点から検討がなされてきましたが、安全保障情勢の緊張を踏まえた同志国連携によって、同様の品目の規制に関して我が国も然るべく対応していることが、海外からも明確にわかるようになるのと同時に、重要な課題となってきているものと思われます。品目ごとのカテゴリー体系であるEUの規制番号体系は、完全にデファクトスタンダードとなっており、我が国も含めた先進諸国や国連のアウトリーチ活動の成果として輸出管理法制度・運用の整備が進んでいるアジア諸国においてもEU体系が採用されていますので、それら諸国の協力を得る上でも重要な課題になってきていると思われます。また、G7合意に基づくロシア制裁における輸出規制においても、品目とEntityに着目して、正面から「輸出禁止」とする規定の整備が行われ、我が国においても対応がなされました。Entityに着目した規制は先述のエンドユーザー規制になりますが、品目についてのリスト規制と同様、明確性、予見可能性、輸出企業の管理負担の観点から優れた規制手法だと思われるので、今後の同志国連携における協議の中で、検討をお願いできれば幸いです。</p>
<p>1. ル</p> <p>【意見】 EUVベリクル専用の製造装置を想定していると理解しましたが、ArF用などにも使用している装置は対象外で良いのでしょうか？</p> <p>【理由】 規制対象の装置を明確化したい。</p>
<p>2. ラ</p> <p>【意見】 将来的な国際レジームとの合意を考慮すると、専用チェックオーバーレイ(DCO)精度による限定化が必要ではないでしょうか。</p> <p>【理由】 仕様を導入し、規制対象となる装置を明確化していただきたい。</p>

<p>3. フ</p> <p>【意見】 EUVレジスト専用の塗布、ベーク、現像装置を想定していると理解しましたが、ArF用などにも使用している装置は対象外ででしょうか？</p> <p>【理由】 規制対象の装置を明確化したい。</p>
<p>4. カ、ヨ</p> <p>【意見】 「エッチング選択性」を解釈で規定いただきたい。</p> <p>【理由】 「解釈：貨物等省令第6条第十七号カ（一）中のシリコンゲルマニウムのシリコンに対するエッチングの選択制の比率」はありますが、「エッチング選択制」という用語の解釈はなく、規制対象の装置を明確化するためにも解釈を新設いただきたい。</p>
<p>5. レ（一）</p> <p>【意見】 「電気メッキ」の適用先(デザインルール等)やスペック、及び成膜の状態(膜厚や膜中コバルト含有量など)に関するスペックを明確にすべきであると考えます。</p> <p>【理由】 規制対象の装置を明確化したい。</p>
<p>6. レ（二）</p> <p>【意見】 「ボトムアップ成膜」を解釈で規定いただきたい。</p> <p>【理由】 規制対象の装置を明確化したい。</p>
<p>7. レ（三）、（四）、（七）</p> <p>【意見】 「金属のコンタクト層」を解釈で規定いただきたい。</p> <p>【理由】 規制対象の装置を明確化したい。</p>
<p>8. レ（九）</p> <p>【意見】 銅の拡散防止膜であれば「融点1500°C以上を有する高融点金属を●%atom以上含む薄膜」などに限定すべきと考えます。</p> <p>【理由】 「バリアー膜やライナー」では対象が広すぎるので、上記のパラメータを導入して規制範囲を限定すべきです。</p>
<p>9. ツ</p> <p>【意見】</p> <p>① 「バリアー膜を用いずに選択的に」を「解釈」で定義してほしい。</p> <p>② 「不活性ガスの環境において成膜」を「物理蒸着法」と修正いただきたい。</p> <p>【理由】</p> <p>① 規制対象をより明確化するためです。</p> <p>② おそらく物理蒸着法を念頭に置いた規制だと思いますが、「不活性ガスの環境において成膜」という表現には矛盾があると考えます。スパッタ法であっても、アルゴンや窒素のプラズマ状態を不活性ガスの環境と言って良いのか疑問が残ります。物理蒸着法と記した方が良いのではないのでしょうか？</p>
<p>10. ム</p> <p>【意見】</p> <p>① EUVマスクブランク専用スパッタ装置を想定していると理解しましたが、ArF用マスクブランクなどにも使用している装置は対象外でいいでしょうか？</p> <p>② 「極端紫外を用いて集積回路製造用PHOTOMASKに用いられる多層反射膜の成膜用として設計された装置」の理解でいいですか？</p> <p>【理由】</p> <p>規制対象の装置を明確化したい。</p>
<p>11. キ</p> <p>【意見】 「厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜するように設計した装置」を「厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、圧縮応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜するように設計した装置」</p> <p>【理由】 「応力」が「圧縮応力」のことならば、きちんと「圧縮応力」と省令上に規定すべきだと考えます。</p>
<p>12. マ</p> <p>【意見】</p> <p>① 複数のチャンパー又はステーションを有し、洗浄用に設計したドライブプロセスの装置」が該当であり、「複数のチャンパー又はステーションを有し、ドライエッチング用に設計したドライブプロセス装置」は、非該当又は対象外という解釈でいいでしょうか。</p> <p>② マルチチャンパー装置はほとんどすべての装置で、クリーニングガス、もしくはArを有しており、もし全てが規制対象になるのであれば、規制範囲をより具体的に示していただきたい。</p> <p>③ 「ドライブプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理」や、「ドライブプロセスによる表面汚染物の除去」は、いわゆる先端半導体の製造プロセスではない半導体製造プロセスにおいても、一般的に行われる処理です。例えば非該当のドライエッチング装置でも、上記の処理は可能であるし、ダイシング装置、プラズマクリーニング装置、ハイブリッド接合装置など、後工程の装置ですら上記の処理が可能なチャンパーを有します。原文の条文のままだと、先端半導体の製造装置を規制する意図とは全く関係なく、幅広くさまざまな装置が規制されてしまいます。上記の理由により、条文に詳細な仕様を記載するか削除していただく様お願いします。</p> <p>④ 「複数のチャンパー又はステーションを有する装置であって、ドライブプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの 又はドライブプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの」を次のように修正いただきたい。</p> <p>「複数のプロセスチャンパー又はステーションを有する装置であって、ドライブプロセスによりウエハー表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライブプロセスによりウエハー表面の汚染物を除去するように設計したもの」</p> <p>⑤ 複数のチャンパー又はステーションを有する洗浄又は表面異物除去装置であって、と文言を追加いただきたい。</p> <p>【理由】</p> <p>①② 規制対象範囲を明確化していただきたい。</p> <p>③④ 「プロセス」を入れることにより、ウエハー搬送の空間としてのみ使う真空チャンパー、すなわちプロセス処理に使わないチャンパーを除外して明確化するためです。またプロセス処理する対象である「ウエハー」を入れることにより、前工程の半導体製造装置の規制であることを明確化するためです。</p> <p>⑤ 洗浄が主の装置である事を明確にするためです。</p>
<p>13. ケ</p> <p>【意見内容】</p> <p>① 枚葉式のウェット洗浄装置であってウエハーの表面改質の後に乾燥を行う工程を有するものとする。</p> <p>② 「ウエハーの表面改質」を「解釈」で規定していただきたい。</p> <p>「貨物等省令第6条第十七号ケのウエハーの表面改質」：</p> <p>ウエハー表面（回路生成する側の面を言う）の組成や構造を、成膜、露光、ドライエッチング工程時にイオン照射、加熱、薬液によって変え、表面の性質や特性を変えることをいう。</p> <p>ウエハー表面の異物又は金属等の汚染物質の除去は含まない。」</p> <p>③ 装置に組み込まれている洗浄ユニット(装置に洗浄機能として付いている)は、規制対象になりますか？</p> <p>【理由】</p> <p>① 装置の主たる機能が洗浄である事を明確にするためです。</p> <p>② 規定される「表面改質」の定義を明確にすることによって、規制対象となる洗浄装置が明確化されます。原文の条文のままだと、「水以外の液での洗浄」など、幅広い処理を「表面改質」と解釈することができてしまい、先端半導体の装置を規制する意図とは全く関係なく、枚葉式のウェット洗浄装置の大部分が規制されてしまう懸念があります。</p> <p>③ 解釈やQ&Aで解説でも可ですが、判断迷わないようにしていただきたい。</p>

	<p>14. フ</p> <p>【意見】</p> <p>① EUVブランク・EUVマスクのパーティクルや欠陥の検査装置が対象と理解しましたが、この規定ではEUVマスクの寸法や配置精度や反射率等の検査装置も対象になるように誤解されます。パーティクルや欠陥の検査装置が対象である旨の明確化をお願いします。また、将来的な国際レジームとの合意を考慮すると、精度による限定化が必要ではないでしょうか。</p> <p>② “検査するように設計した装置”を判別する基準は何になるのでしょうか。既存のPhotolithographyに用いられるマスクブランクス又はPHOTOMASKを検査する装置との区分け基準の明確化をお願いします。</p> <p>③ 今回の規制はEUVマスクの検査装置に対する規制ですので、設計の前に”特に”という文言を入れ、より明確化することを希望します。</p> <p>【理由】</p> <p>規制対象の装置を明確化していただきたい。</p>	
	<p>15. 部分品、附属品</p> <p>【意見】 省令第6条第十七号は、部分品・附属品も規制されていますが、規制される部分品・附属品は該当装置用に専用設計されたもののみが規制されるのでしょうか？該当装置/非該当装置の両方に使用するために設計した部分品や、非該当装置用に設計した部分品は、該当装置にも使用する部分品でも対象外で良いのでしょうか？</p> <p>【理由】 今般のバリックコメントの対象ではありませんが、あらためて23品目が追加になるのを機に、これらの輸取出引が増えると思われるために確認します。</p>	
	<p>1. 第十七号の二</p> <p>【意見】</p> <p>① ベリクルの定義を運用通達の解釈に新設いただきたい。</p> <p>② 当該EUVベリクルを装着したマスクは10%ルール「他の貨物の部分をなしているもの」で判断するのでしょうか？</p> <p>③ 対象の完成品は、EUVベリクルのみであって、その構成部材である膜、フレーム、接着剤粘着剤等は該当しないと理解していいでしょうか？</p> <p>④ EUV（極端紫外線）露光装置に使用するために設計されたベリクル、かつ、集積回路製造用に限定されているベリクルとの理解で正しいですか？</p> <p>⑤ なぜ、省令で”十七号の二”なのでしょう？また、省令に新貨物として追加されるのであれば、政令にも追加する必要があるのではないのでしょうか？</p> <p>⑥ 今回追加されたEUV用のベリクルはそもそもEUV露光機が無いと、意味をなさないと考えられ、またベリクルが無くてもマスクを製造できるため、今回の輸出規制を実施する意味があまり感じられないように思えます。</p> <p>【理由】</p> <p>①～④規制対象のベリクルを明確化していただきたい。</p> <p>⑤ EUVベリクルを「十七号」ではなく「十七号の二」に規定した理由：規程の構造は次とおりですが、EUVベリクルの規制を強調するためでしょうか。7の項（17）、省令第十七号では、現状マスクの部分品・附属品も規制されています。即ち、ベリクルも規制されている整理かと思います。これに対して、バブコメ案では、十七号の柱書で（次号に該当するものを除く。）次号＝第十七号の二のEUVベリクルのみ独立させて規制した意図だと理解しました。即ち、EUVベリクルは第十七号の二、その他のベリクルは第十七号で規定していますが、政令では、どちらも7の項（17）に入ると理解していますが、この理解でいいでしょうか。</p> <p>⑥ 規制する意味を確認したい。</p>	
44	<p>・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。）</p> <p>（1）省令改正案の第六条17項 ヨ「ウェットエッチング用に設計した装置」</p> <p>（2）省令改正案の第六条17項 ヨ「選択性の比率」</p> <p>（3）省令改正案の第六条17項 ケ「表面改質」</p> <p>・意見内容</p> <p>（1） 「ウェットエッチング用に設計した装置」の定義明確化のため、①GAA（Gate All Around）構造のトランジスタを形成する際のウェットエッチング装置のことを指すことと、②洗浄装置を含まないことを、解釈として明示いただきたいです。</p> <p>（2） 「選択性の比率」に関して、選択比をコントロールする機能を有していない場合は、本項番の対象外であることを、解釈として明示いただきたいです。</p> <p>（3） 「表面改質」の定義として、①「ウエハーの表面自体を変化させ、新しい機能を付加すること」であることと、②「表面処理（液体の表面張力を低下させる等、ウエハー表面の状態を変えることによって表面の性質を変える）」やレジスト剥離とは異なるものであることを、解釈として明示いただきたいです。</p> <p>・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。）</p> <p>（1） 法令文面を元に、「ウェットエッチング用に設計した装置」の定義を、上記のとおり理解しております。また、洗浄装置については「ヤ〜ケ」で別途項番が設けられており、項番間の重複排除の観点から、「ヨ」には洗浄装置は含まれないと理解しております。</p> <p>規制対象品目が立法意図よりも拡大解釈された場合、わが国の企業・産業界の競争条件が、他国と比べて不利になる恐れがあり、定義明確化が必要と考えます。</p> <p>（2） ウェットエッチングはケミカルの特性に依存するため、選択比を装置側でコントロールすることは非常に困難な技術であると理解しております。選択比をコントロールする機能を有していない場合は、そもそも「エッチングの選択性の比率が100倍以上であるもの」にはあたらないと考えます。</p> <p>（3） 上記のとおり、「表面改質」は「表面処理」とは異なるものと理解しております。同様の理由により、いわゆる「レジスト剥離」は、「ウエハーの表面改質」にはあたらないと理解しております。</p> <p>法令の正確な解釈により、本規制を適切に運用することができると考えます。また、規制対象品目が立法意図よりも拡大解釈された場合、わが国の企業・産業界の競争条件が、他国と比べて不利になる恐れがあると考えております。</p>	<p>御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。</p>
45	<p>・6条17号 全般</p> <p>意見：省令6条17号で施行済みのイ、ロ、ホ、ヘ、ヌ等の部分品の判定では、半導体製造装置の該非に依存し、装置が該当なら部分品も該当、装置が非該当なら部分品も非該当となるという判定方法が、一般に採られている。今回追加されるル？フの部分品についても、従来の判定方法と同様であることを明確化して頂きたい。</p> <p>理由：省令6条17号にいう「部分品」及び「附属品」の定義及び判定方法が明らかでなく、同号の適用を受けるか否かの判断が困難である。</p> <p>意見：省令の公式英語訳を作成頂きたい。</p> <p>理由：日本の部品メーカーにとって、装置の規制スベックに関する条文の内容は、日本語でも難しい。もし、日本の部品メーカーが条文を不正確に英訳し、海外の装置メーカーに判定してもらうと、該非判定を誤る可能性がある。従前は国際輸出管理レジームのワッセナーアレンジメント等の原文を使用して海外の装置メーカーに確認することができたが、今回の省令改正案は使用できる英訳が無い。</p> <p>・6条17号 カーニ―3</p> <p>意見：静電チャックの仕様について、温度制御可能領域は「20以上」ではなく、「100以上」として頂きたい。</p> <p>理由：最先端の静電チャックは150領域以上の温度制御が可能であり、もはや20領域の温度制御は最先端ではなく、輸出規制の対象として妥当ではない。軍事転用を防ぐという目的からすると、100領域以上とすることが妥当である。</p> <p>・輸出許可／不許可の判断</p> <p>意見：輸出許可／不許可の事前審査制度を設けて頂きたい。</p> <p>理由：これまで日本の部品メーカーが海外の装置メーカーに輸出できていた製品が、省令改正により輸出できなくなった場合、代金の回収、仕掛品の費用の回収等ができなくなり、事業に大きなインパクトを与える。</p> <p>・輸出許可申請書類の誓約書の最終需要者の確認</p> <p>意見：日本の部品メーカーが海外の装置メーカーに半導体製造装置の専用部品を輸出する場合、輸出許可申請書類の誓約書の最終需要者は、半導体製造装置メーカーであって、装置が納入される半導体チップメーカーではないことを明確化して頂きたい。</p> <p>理由：部品メーカーとしては、通常、半導体製造装置メーカーから誓約書を取得することは可能としても、装置のユーザーである半導体チップメーカーの正確な情報を得ることは困難であり、誓約書の取得は極めて難しい。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行い、原則として、従前から管理対象となっている半導体製造装置と同様の管理を行うものです。このため、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたします。貨物等省令6条第17号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第17号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要な不可欠であるか否かになります。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

	<p>一、輸出許可に関する「草案」規定の更なる修正</p> <p>日本の輸出管理関連法令によれば、規制品目に係る輸出許可は、基本的には個別許可（Individual License）と包括許可（Bulk License）の2種類があります。個別許可は、取引ごとに発行され、有効期間は6ヶ月です。包括許可は、一度発行されると、3年の有効期間内に複数回の取引において使用でき、包括許可は輸出取引の手続を簡略化することができます。また、包括許可は、輸入国・地域及びシナリオに応じて、一般包括許可（General Bulk License）、特別一般包括許可（Special General Bulk License）、特定包括許可（Special Bulk License）及び不具合による返品・修理、日本企業の海外子会社への輸出等のための特定の場合の包括許可に分けられています。上記の包括許可について、一般包括許可は、特定の国（中国大陸・香港・マカオを含まない。）への輸出のみに適用されます。一方、特別一般包括許可は、これまで中国大陸への一部の輸出に適用されますが、「草案」により新規で追加された規制装置の輸出には適用されなくなります。この点について、このような取り扱いを新規に設けた具体的な理由をより明確にいただき、また、係る政策変更により日中両国の企業の法令遵守の義務と負担が重くなる可能性があることをご理解いただきたく存じます。</p> <p>1.（これまで中国大陸への一部の輸出にも適用される）特別一般包括許可は、基本的に取引先やエンドユーザーにより取り扱いが異なることはなく、輸出者が特別一般包括許可を取得した後、中国大陸での複数のエンティティに対し輸出することができます。但し、特定包括許可は、同一の取引先への複数回の輸出の場合にしか適用されず、輸出者である日本企業は、中国大陸での異なる取引先について輸出許可を複数回申請しなければならないため、日本企業の法令遵守のための負担が重くなります。このような日本企業に課する義務は、取引先である中国企業にも影響を与えます。例えば、許可申請のための資料提供や関連する法遵守のための対応作業により、仕入プロセスが遅れ、その事業の遂行に悪影響を及ぼす可能性があることも考えられます。</p> <p>2. また、特定のエンドユーザーへの輸出に適用される特定包括許可は、輸出入の双方が「継続的な取引関係」にあることが求められます。これにより、中国企業による新規追加された規制装置の仕入れについて、さらに法令遵守のための義務が課せられ、かつ、小口の仕入れニーズを持つ企業が実質的に特定包括許可の対象外とされたと理解しております。上記の潜在的な影響を考慮し、①「草案」で新たに規制される予定の装置を中国大陸・香港・マカオに輸出する場合でも、特別一般包括許可を適用すること、又は、少なくとも②「ホワイトリスト」制度を設け、日本のコンプライアンス要求に合致する企業を「ホワイトリスト」に掲げ、当該企業への輸出に特別一般包括許可を適用することを提案いたします。また、許可申請書類について、「草案」によれば、新規規制装置を中国大陸・香港・マカオ・台湾等の国・地域に輸出する場合、提出すべき書類は比較的複雑です。例えば、エンドユーザーの存在及びその事業内容を証明する書類、並びにエンドユーザーの承諾に関する書類等の提出が必要とされます。関連書類の複雑さ及び貴省が既に公布した許可申請の審査において考慮すべき要素の幅広さ（主に関連品目が実際にエンドユーザーに提供され、かつ実際にエンドユーザーに使用される可能性、及び関連品目の移転が国際的な平和と安定を阻害する可能性等）に鑑み、中国企業が貴省のコンプライアンス管理上の要求によりよく対応し実行できるよう、許可申請書類の要求をより詳細に定め、また、許可申請の審査において実質的に考慮される要素に関するより詳細な規定を設けることをご検討いただけますようお願い申し上げます。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。なお、今回の措置も、従前の改正と同様、施行日以降に輸出される貨物が対象であり、公布から施行まで2カ月の周知期間を置くことを予定しています。</p>
46	<p>二、「草案」における軍事用途の定義の更なる明確化</p> <p>貴省の西村経済産業大臣が「草案」に関する記者会見にも表明したとおり、「草案」の主な目的としては、軍事用途への使用を規制することです。即ち、関連措置が「禁輸」ではなく、規制の強化であり、高性能な先端半導体等の製品が軍事用途に転用されると、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるため、「草案」に定める新規規制製品、技術等が軍事用途に転用される可能性を審査し、軍事用途に転用されるおそれがない場合、通常通りに輸出することができます。このため、今回の法改正に関し、中国企業が関連規制品目を調達する場合、「軍事用途」に関する懸念を払拭するため、関連証明書類を積極的に提供することが思料されます。但し、現時点において、「草案」は、「軍事用途」に関する具体的な定義又は日本政府の判断基準と根拠を定めていないようです。その結果、多くの中国企業が貴省のコンプライアンス要求に正確に対応できないおそれがあります。また、今回の「草案」の影響を受けるのは主に半導体生産企業（特にFoundry）であると考えられますが、Foundryは半導体産業チェーンの中流にあり、通常、半導体製品のエンドユーザーと直接に接触せず、かつ、製品のエンドユーザーでの用途を全面的に把握することができません。従って、関連規定が曖昧なところがあることにより、実務上誤解が生じかねないこと、また「草案」の影響を受ける可能性のある半導体企業の産業チェーンにおける位置づけ等を踏まえ、以下の修正を提案いたします。</p> <p>1. 「軍事用途」について、定義又は関連判断基準を明確化し、又は参考のために軍事用途に関わる典型的な例を挙げること</p> <p>2. 「軍事用途」に関わるか否かを審査する際に主に考慮する要素を明確化すること</p> <p>3. 関連するコンプライアンス要求をトリガーする条件を明確化すること。例えば、輸出者が業務が軍事用途に関わる可能性があることを明らかにする場合であるか、それともより厳しい基準が適用されるか。</p> <p>4. 「草案」に定める規制装置の取引先が主にFoundryであり、Foundryが通常エンドユーザーに直接に接触しないことに鑑み、より明確なガイドライン（特に実務上、半導体設計・製造等の産業チェーンの上流・中流にある企業は、どれほどのデュエディリジェンスとコンプライアンス関連の対応を行ったら、日本政府による軍事用途に関するコンプライアンス管理上の要求に適合するのか）を提供すること</p>	
	<p>三、法改正後に生じうる契約履行上の問題に対する規定/説明の詳細化</p> <p>通常、「草案」のような比較的重要な法改正を行う場合、関連政府当局が、法改正の発効について猶予期間を設けることが多く見受けられます。輸出管理問題の特殊性等に鑑み、法改正が猶予期間のないまま発効すると、日中両国の企業の正当な利益に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、「草案」の規定が直ちに発効すると、通常、半導体装置製品の納期が比較的に長いことに鑑み、多くの日本企業は、法改正の発効前に既に締結した契約に基づく納品義務を履行できないことにより、契約違反の責任を負わされる可能性があります。一方、取引先である中国企業は、納期通りに関連設備の納品を受けられない場合、その後の生産も影響を受け、損害を被ることになります。さらに、中国企業が日本企業に対し損害賠償責任を請求することにより、日本企業がより大きな潜在的損害を被るおそれがあります。以上に鑑み、以下の提案についてご検討いただけますようお願い申し上げます。</p> <p>1. 日中両国の企業が猶予期間内に、法改正の発効前に既に契約を締結した業務を順調に遂行し、法改正による巨額の損失を回避できるように、法改正の発効について十分な猶予期間を設けること。</p> <p>2. 法改正において明確な除外規定を設けること。即ち、法改正の発効前に既に締結した契約について、契約の対象物である関連製品が日本から輸出されるのが法改正の発効後である場合でも、係る輸出活動は、法改正の影響を受けない。</p> <p>3. ビジネスの観点から、半導体装置のライフサイクルが比較的に長く、かつ、業界の大手企業の完備なアフターサービス体制もその高い市場競争力の重要な一環であると考えます。仮に装置の提供者が安定したアフターサービスを提供することができない場合、取引先の生産に悪影響を及ぼし、かつ、その正当な商業利益に重大な損害を与える可能性がある一方、装置の提供者の産業競争力及び企業イメージに深刻な悪影響を及ぼしかねません。法的観点から、日常的な補修・メンテナンス、デバッグ、部品交換等のサービスについて、規制対象装置に関連する規制対象技術の開示が必ず伴うものではないと理解しております。従って、日中両国の企業の合法的な権益をよりよく保護するため、法改正の発効前に既に輸出した装置について、装置の輸出者による法改正発効後のメンテナンス等のアフターサービスが法改正の影響を受けまいよう明確にすることについて、ご検討いただけますようお願い申し上げます。</p>	
47	<p>なにも輸出に関して透明性が確保されたわけでもない現状が変わらないのになぜ緩和するのか不明。絶対反対。国民の生命財産を守ることを放棄して政治遊びをするな！</p>	<p>今般の措置は、半導体製造装置に関する輸出管理を強化するものです。</p>
48	<p>こんばんは。難しい話でよく分からず意見を、先に書いておきます。韓国が北朝鮮やイランなどに横流しできないように、きっちり管理を徹底させるようお願いします。そのために厳しくするのなら賛成です。韓国が横流した結果、安全保障に重大な危機が起こった場合、輸出した日本が世界から制裁されてしまいます。今までの様々な反日行為を見るに、絶対に日本を裏切ります。特に韓国への輸出は十分すぎるほど監視の目を光らせておいてください。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
49	<p>対中に対して、軍事転用される物を規制する事を望みます。また、情報漏洩、技術漏洩も厳しく規制よろしくお願い致します。追加でジャパニーズディスプレイの有機E L（軍用機使用の危惧）の規制と国内製造を国で支援し、保護して頂きたいです。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
50	<p>1.【省令】輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令案に関する疑問点・懸念点事項</p> <p>1)今回の改正案では最新機種だけでなく、すでに多くの顧客に販売している現行機種が規制対象に含まれています。他国の先端半導体エンドユース規制よりも厳しい規制のように思われ、同盟国が同レベルの規制としなかった場合、ビジネス上の大きな不利益を被ることになります。日本の規制内容が他の同盟国の規制内容と同等あるいはそれ以下のものであることを担保していただきたいと考えます。また、すでに販売した装置のメンテナンス用部品に関しては、制限を付さないようお願いします。</p> <p>2)今般新たに設けられる規制貨物に関しては、省令第6条に規定されることから、いわゆる「少額特例」及び「無償特例」の対象となり得る(輸出令別表第3の3に規定されるものではないため、「少額特例」に関しては、総価額100万円まで可)との理解で宜しいでしょうか。</p> <p>3)役務の提供について</p> <p>①係る装置について、役務の提供に関する規制はないと理解していますが、その理解が正しいでしょうか？</p> <p>②もし、役務の提供に規制がかかるのであれば、規制対象となる役務者の範囲を明確に示してください。</p> <p>例えば、立ち上げや、メンテナンスにあたり、日本に居住する日本人が現地に向いて役務を提供することは規制の対象となるのでしょうか？ また、現地法人である地域に住居するその国の国籍を有する役務提供者も規制の対象となるのでしょうか？</p> <p>2.【通達】包括取扱要領の一部改正案に関する疑問点・懸念事項</p> <p>1)と地域③の顧客については特一包括が使えないため、立ち上げやメンテナンスで部分品の出荷が多数ある場合は、顧客ごとに特定包括許可を取得するしかないかと思われませんが、特定包括許可は、継続的な取引関係を有する同一の相手との間に行う取引について、包括的に輸出又は役務取引を許可する制度であるため、実態としては、当面の間、個別許可申請の選択肢しかなく、いずれにおいても各社が一斉に個別許可、または特別包括等の申請をした場合のスムーズな審査体制を構築していただかないと部分品の出荷に影響が出るのではないかと危惧しています。業務が円滑に遂行されるよう、包括許可に対する効率的かつ合理的な運用システムの確立をお願い致します。</p> <p>3.その他</p> <p>1)リスト規制に追加される23品目について、個別許可申請をした場合、申請から許可が出るまでに要する時間はどれくらいと想定されるのでしょうか？</p> <p>2)リスト規制に追加される23品目について、個別許可が必要な地域の企業を親会社に持つが、個別許可不要な地域の子会社向けに輸出する場合、包括許可が適用され、個別許可は不要となりますか？</p> <p>3)今後、先端半導体製造用途がキャッチオール規制の用途要件に追加される可能性はあるでしょうか？</p> <p>4)経産大臣の記者会見では、今般の措置に対し事前に同志国との意見交換を行っており、将来的にはワッセナーアレンジメント（WA）への提案を目指すコメントされています。事実として日本の半導体製造装置メーカーは、海外の同業他社との熾烈な競争を余儀なくされている状況です。国際レジームでの合意が得られる以前のタイミングにおいても、少なくとも同志国とは事前調整の上、規制内容に齟齬がないことを確保頂くとともに、その発動時期についても出来る限り同期頂くようお願い致します。</p> <p>5)専用部品の特定方法について</p> <p>専用部品の特定に関して具体的な基準が示されていませんが、必要不可欠かどうかは自社基準によって特定してよいということでしょうか？</p>	<p>今回追加される半導体製造装置について、御質問の点に関して従前から管理対象となっている装置との違いはございません。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

51	<p>尊敬する日本国経済産業省の指導者の皆様</p> <p>2023年3月31日、貴省は『外国為替及び外国貿易法』の改正案を発表し、輸出前に貴省の事前承認を必要とするチップ製造装置の範囲を拡大するとしました。すなわち、日本の輸出者が、米国、シンガポール、中国台湾など42カ国・地域へ6分類（23種類）のチップ製造装置を輸出する際に一般許可を適用することとし、上記チップ製造装置の中国を含むその他の国・地域への輸出は、ケースバイケースで個別承認が必要とする規制（「改正」または「新規制」）です。今回の改正案は、2023年3月31日に公表されパブリックコメントを公募し、5月に正式発布、7月に施行される予定です。</p> <p>私たちは、中日間の貿易、投資、その他の経済・貿易活動に長く携わってきた法律実務家として、今回の改正を非常に懸念しており、中日両国の半導体産業の実務と国際半導体輸出規制の現状を考慮し、ご検討のために新規制に関するコメントと提言を申し上げる次第でございます。貴省に、今回の改正が日本の半導体製造装置メーカーや世界の半導体サプライチェーンに与える潜在的損害を考慮し、新規制の対象品目の範囲を慎重に評価し、該当する半導体製造装置に適用される輸出管理政策を再考いただくことを希望致します。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、御指摘のように特定の国を念頭に置くものではなく、国際ルールに整合的に実施するものです。このため、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。また、今回の措置も、従前の改正と同様、施行日以降に輸出される貨物が対象となります。いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
	<p>一、コメント</p> <p>(一) われわれは、新規制による半導体製造装置の管理範囲が広すぎると認識し、管理範囲を適宜に狭めることを提言します。</p> <p>(1) 新規制の対象となる半導体製造装置は実際成熟したプロセスでしか使用されておらず、軍事的利用の可能性は認められません。</p> <p>一部のクライアントと意見交換をした結果、彼らが現在生産に使用している装置が、この新規制の対象に該当することが判明しました。しかし、当該装置は、成熟したプロセスのチップ（28nmのロジックチップ、18nm以上のDRAM、128層以下のNAND）または当該チップの上流材料（チップ製造に使用されるシリコンウェハーなど）の製造にのみ使用されるものであり、当該装置および当該装置によって製造されるチップは軍事利用の条件および可能性を認められません。また、現在、各国は一般的に非先端プロセスDRAMなどの輸出規制を行っていません（例えば、米国EARにおいて、非先端プロセスDRAMチップは一般的にEAR99に分類され、中国への輸出はライセンスを必要としない）。このように、非先端プロセスでしか利用されていない半導体製造装置に規制を課する必要性は認められません。当該装置に対する不必要な規制は、軍事利用を制限するという貴省の改正の目的に合致しないばかりか、既存の産業チェーンの成果を損ない、中日両国の企業の利益を損なうことになりかねません。一方で、米国の対半導体製造装置輸出管理政策は、軍事利用の可能性がある場合にのみ適用するという明確な方向性を持っており、中国の半導体メーカーが日本の半導体製造装置を使用して軍事用チップを製造するという明確な証拠がない状況で、一律に半導体製造装置に厳しい輸出管理措置を課すことは、輸出管理政策の乱用にあたるものと考えます。</p> <p>(2) 今回の改正案における技術パラメータの記載が広すぎて、米国や多国間協定の管理範囲をも超えています。</p> <p>新規制で管理対象となる半導体製造装置の技術パラメータの記述が広すぎるため、それに基づくと、新規制の管理範囲は貴国が加盟しているワッセナー協定等の国際枠組みのそれを超えるものとなります。当事務所の比較によれば、新規制の管理範囲は、米国の輸出管理規則の対象範囲をも部分的に超えています。2023年10月7日に発表された米国の新しい輸出管理規則のECCN 3B090は、高度な半導体薄膜成膜装置のみが対象です。一方で、貴省の新規則では、先端半導体製造装置のうち、「洗浄、薄膜堆積、アニーリング（熱処理）、リソグラフィ（露光）、エッチング（化学的除去）、検査など」の6品目を対象としており、新規制項目の範囲はECCN 3B090の項目の範囲を大きく超えています。また、今回の改正では、米国が輸出規制を採用していない中流の半導体洗浄装置も追加で規制の対象となっています。</p> <p>貴国と我が国のチップ産業チェーンは相互依存関係にあり、貴国の半導体製造装置メーカーは我が国の半導体関連上流・下流企業にとっては重要な装置サプライヤーであり、我が国のマーケットは貴国にとって最大のマーケットの一つであります。その状況を鑑み、双方の企業の相互依存関係に十分配慮し、双方の経済・商業の繁栄の観点から、軍事利用を防ぐことを目的に必要な最小範囲で輸出規制をご検討いただきたいと切に願います。貴国が軍事装置またはデュアルユース装置の輸出管理を行うことで、両国企業間の通常の商取引に影響を与えないよう、希望致します。</p> <p>(3) 新規制案の技術パラメータの記述が曖昧になっている箇所があり、企業がコンプライアンスの準拠基準を判断するのが困難になるおそれがあります。</p> <p>半導体製造装置の具体的な技術パラメータと制限基準に関して、新規制の記述が曖昧になっている箇所があるため、企業がコンプライアンスを遵守する際判断が困難になるおそれがあります。エビタキシャル成長装置を例にとると、今回の改正で、エビタキシャル成長装置とは、「シリコン(炭素を添加したものを含む。) 又はシリコンゲルマニウム (炭素を添加したものを含む。) のエビタキシャル成長用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの」 (a) 複数のチャンパーを有し、かつ、複数の工程間において0.01バスカル以下の真空状態又は水と酸素の分圧が0.01バスカル未満の不活性な環境を維持することができるもの (b)前処理としてウェハーの表面を清浄化するために設計したチャンパーを一以上有するもの(c)エビタキシャル成長の動作温度が685度以下であるものとなっています。同様の項目について米国の法律3B001.aでは、次のようになっています。a.1シリコン以外の材料層を75mm以上の距離で、膜厚均一性が±2.5%未満で製造するように設計または改善された装置a.2アルミ、ガリウム、インジウム、ヒ素、リン、アンチモン、窒素から2つ以上の化合物を使用するために設計された金属有機化学気相成長法 (MOCVD) 装置 a.3 ガスまたは固体ソースを用いた分子線エビタキシャル成長装置。両者を比較すると、米国法におけるエビタキシャル成長装置の技術パラメータがより分かりやすく明確な記述となっていることが分かります。一方、今回の改正で追加されたエビタキシャル成長装置における「複数のチャンパー」や「複数の工程」は定量的基準ではなく、企業が関連する半導体製造装置が管理範囲に該当するかどうかを判断するのはきわめて困難であります。</p>	
	<p>(二) 今回の改定は、日本のサプライヤーの利益や世界の半導体サプライチェーンの発展を損なうおそれがあり、業界の実情に照らして管理範囲を適宜に調整することを提言します。</p> <p>(1) 日本の半導体製造装置メーカーにとって、中国市場が重要であります。</p> <p>われわれは、日本の半導体産業や企業にとって、中国市場は非常に重要なマーケットであると理解しています。日本の主要メディア・日経新聞中国語版の報道によると、日本の半導体製造装置の輸出先国のうち、中国は全体の40%を占める最大の市場であります。国連国際貿易センターの統計によれば、日本の中国向け半導体製造装置輸出額は2021年に約120億ドルに達し、輸出総額の40%近くを占めており、どの地域よりも高く、実に米国の中国向け装置輸出額の2倍近くとなっています。また、日本輸出入のウェブサイトによると、日本の半導体製造装置の収益の約20～30%は中国本土市場におけるものであります。今回の輸出管理の改正では、日本の半導体メーカー十数社へ、最大で収益の20～30%に影響を及ぼすと予想されます。日本の装置メーカーは、洗浄、テスト、エッチングなどの分野で強い技術力を持っており、中国本土への輸出は日本の装置メーカーの収益の20～30%程度を占めております。半導体製造分野において中日企業は深い経済貿易協力関係にあり、日本の対中輸出管理規制は、日本国内の半導体製造装置メーカーの通常の経営にもたらすだけでなく、世界の半導体産業チェーンの協力と革新にも甚大な影響を与えるでしょう。半導体製品と技術の進歩はグローバル市場の協力に依存しており、日本が中国市場を国際半導体産業システムから排除する行為は、最終的に日本国内メーカーの利益と国際半導体産業エコロジーにダメージを与えることになりかねません。</p> <p>(2) 新規制の影響を避けるために、日本国内の産業チェーンが外部にシフトする可能性があります。</p> <p>貴国の輸出管理法規には、米国輸出管理規則のような外国直接製品ルール(Foreign Direct Product Rule)が存在せず、また、外国直接製品ルールを作成する条件が備わっていないと理解しています。そのため、広すぎる輸出管理による影響をさけるために、将来、貴国の企業が海外で工場を設立し（例えば、東南アジアへ工場を移転させ、生産を行う）対応する可能性があることを認識しています。そうすることで生産される関連装置が、貴国の輸出管理規制の対象外となるからであります。我々は、このような産業チェーンの移転は、貴国の半導体製造装置産業の発展と革新に深刻な影響を与え、貴国の地域経済にも大きな不利益をもたらすものと理解しております。貴国の経済と関連産業チェーンへの取り返しのつかない損害を避けるために、貴省に輸出管理範囲の設定に慎重になるよう提言します。</p> <p>(3) 新規制は、中国国内での代替プロセスを加速させることになるでしょう。</p> <p>貴国の新規制で、中国の半導体製造装置メーカーが、特に成熟プロセス分野での国産代替のペースを加速させる可能性があることを認識しております。我々が把握している情報では、一部の国内代替装置が既に生産されはじめています。新規制が正式に発布されれば、中国の半導体製造装置メーカーはさらに国内での研究開発プロセスを加速させるでしょう。それは、日本の半導体製造装置メーカーが将来的に中国での市場シェアを維持することによって、大きな衝撃を与えることになると考えられます。</p>	
	<p>(三)中国に対する差別的な輸出管理政策はWTOルールに違反するおそれがあり、ライセンス政策の調整を提言します。</p> <p>中国は、国連安全保障理事会の常任理事国であり、物品貿易及び製造業において世界の国として、国家の安全を守り、世界の平和と地域の安全を維持するという原則に基づき、これまで常に輸出管理ガバナンスを向上させてきました。中国は輸出管理を非常に重視し、輸出管理実務を積極的に推進し、法制度の確立と施行を通じて輸出管理を強化・規制しています。しかし、いかなる国や地域でも、輸出管理措置を乱用し、不合理的な差別的制限を課し、核不拡散問題に関する二重基準を採用し、さらには輸出管理に関する多国間メカニズムを差別し排他的な方向に押しやることであってはならないという立場であります。『核兵器の不拡散に関する条約』、『細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約』、『化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約』、並びに一連の国連総会及び国連安保理決議はいずれも、すべての国が差別を受けることなく平和利用の権利を十分に享受できるよう規定しています。中国は、輸出規制が公正、合理、無差別の原則に従うべきであり、輸出規制品目の平和利用における他国の正当な権利と利益を損なってはならず、発展のために科学技術の進歩を平和利用し、正常な国際科学技術交流と経済貿易協力、及びグローバル産業チェーンとサプライチェーンの安全かつ円滑な運用に支障が生じてはならないと主張しています。</p> <p>今回の改正では、「日本の輸出者は、米国、シンガポール、中国台湾を含む42の国・地域への6種類（23種類）のチップ製造装置の輸出については一般許可を適用できるが、中国を含む世界の他の国・地域への上記チップ製造装置の輸出については個別承認を受ける」と規定されていることから、中国を含む多くの国にとって、特惠を受けている42の国・地域よりもライセンス取得が難しくなります。この差別的なルールは、世界規模での半導体産業の発展や経済・貿易協力に大きな悪影響を及ぼし、世界の半導体産業チェーンやサプライチェーンの安全な運営にダメージを与えることになるものと認識しております。日本は以前から、輸出対象国をホワイト国と非ホワイト国に分け、それぞれの国に対する貿易政策を区別してきました。2019年8月19日、日本は輸出国をA、B、C、Dの4グループに再分類し、これまで特惠貿易政策を享受していた「ホワイト」国をAグループに、韓国だけが「特別一般包括許可」が適用されるBグループに、中国を含むほとんどの国はCグループに分けられました。</p> <p>「グループA」国への貨物・技術の輸出は、バルクEL (Bulk EL) と経済産業省の地方局が受理する個別ELがメインで、経済産業省が受理する個別ELで補完する仕組みになっているが、相手国のグループランクが下がるにつれ、経済産業省が受理する個別ライセンスの内容が増え、グループD諸国への輸出は経済産業省が受理する個別ライセンスのみとなります。グループCの中国向けの輸出を行う企業は社内でコンプライアンス体制を構築し、経済産業省の監査を受けることを条件に、日本の輸出管理制度に基づくスペシャルバルクEL (Special Bulk EL) と経済産業省地方局からの個別許可を受けることになっています。</p> <p>しかし、今回の新規制により、中国企業は、新たな規制品目リストに含まれる23種類の半導体製造装置のライセンスを申請する際に、スペシャルバルクELと経済産業省の地方局による個別許可を適用しなくなります。これは、新規性が現行のカテゴリーC国に対するライセンス政策と矛盾するだけでなく、中国を含む関連国に対する貿易差別をさらに悪化させるものであり、WTO無差別原則及びWTO協定に基づく貨物及びサービスの貿易に関する無差別原則・平等な待遇（GATT第11条1項、GATT第13条1項等）に違反する疑いがあります。</p> <p>近年の輸出管理分野における中国の最新の立法と実務は、核不拡散等の国際的義務を果たす大国としての役割を示しており、日本に対して差別的な貿易政策や輸出制限を課したことはありません。中国は、日本による中国企業に対するいかなる差別的貿易措置にも反対し、輸出管理分野における両国の積極的協力を奨励し、企業間の良好な経済及び貿易協力を促進しています。</p>	

<p>(四) 新規規は、既存の取引主体の権利と利益を考慮し、緩衝期間を設けるべきと提言します。</p> <p>上記のように、貴国と我が国の企業は、長期にわたり、相互依存、相互促進しながら共生してきました。そのことを鑑み、我々は、貴省が半導体製造装置に対する管理範囲を拡大する際、両国の企業に便宜をはかり、関連する管理措置が両国の企業に不必要なマイナスの影響を最小限にするために、制度プロセスの観点から以下の点に配慮するよう、提言します。</p> <p>1.貴省に、貴国企業と長年取引関係を持つ中国企業ホワイトリストの作成することを提案します。最終用途、最終顧客が軍事的な性質を持たないことを確認するなど、一連の手続きを踏まえたうえで、当該中国企業を信用できるホワイトリストに含め、当該中国企業に対して一般ライセンスまたは類似のライセンスの制度を作成・実施し、当該取引が、輸出管理に関する個別承認の管理によって影響を受けたり遅延したりすることなく、当該取引が合法的かつ準拠した方法で円滑に行われることを最大限確保すること。</p> <p>2.半導体製造装置の生産サイクルが長い実情を考慮し、新規制を実施する際、貴省に両国企業が進行中の既存契約を十分に配慮し、既存契約を完了し、関連産業チェーンを調整し、今後の市場配置を行うために十分な時間が与えられるよう、ライセンス例外を提供するか、十分な緩衝期間を設けることを提案します。そうしなければ、既存契約の強制的な停止で、両国企業間で多くの紛争や訴訟が引き起こされ、両国企業の良好な関係が損なわれ、不必要な訴訟費用と経済的損失を引き起こすことになりかねません。</p> <p>3.我々は、貴省が最終的に輸出管理を決定する半導体製造装置について、詳細なプロセスシステム、書類リストを作成し、ライセンスを付与するかどうかを決定する際に考慮する要素を公表することを提言します。企業がライセンスを取得できるかどうかを正確に評価し、関連要件に対応して貴省が要求する書類の内容を適時かつ包括的に提出できるようにすることで、貴省の管理業務がよりスムーズに行われるだけでなく、両国企業の関連取引を安定させ、経済発展を促進することができるからです。</p>	
<p>II. コメントのまとめ</p> <p>上を要約し、我々は、貴省に中国向け半導体製造装置に関する輸出管理政策の再調整を検討することを下記のように謹んで提言します。</p> <p>1.成熟したプロセスのチップ（28nmロジックチップ、18nm以上のDRAM、128層以下のNAND）または関連チップの上流材料（チップ製造に使用するシリコンウェハーなど）の製造にのみ使用される半導体製造装置に関する新規制を撤廃すること。</p> <p>2.現在規制されていないチップや消費者部門（一般消費者向けの家電製品など）のチップの製造にのみ使用される半導体製造装置に対する新規制を撤廃すること。</p> <p>3.半導体製造装置の「軍事利用」であるかどうかを判断する際に用いられる基準を明確にすること。</p> <p>4.各国における半導体製造装置の管理状況や国際協定を考慮し、新規制による半導体製造装置の管理範囲を、軍事用またはデュアルユースの装置を管理するために必要な最小限に絞ること。</p> <p>5.新規規の対象となる半導体製造装置の技術パラメータと基準をさらに明確化させ、企業が準拠する基準を容易に判断できるようにすること。</p> <p>6.中国に対する差別的な輸出管理許可政策を撤廃すること。</p> <p>7.民間の商取引の正常な実施を確保するため、中国企業ホワイトリストの作成を検討すること。</p> <p>8. 取引主体の合法的権利と利益を保護するため、既存の取引や契約について、緩衝期間やライセンス例外の創設を検討すること。</p> <p>9. 関連するライセンス制度の申請プロセス、コンプライアンス文書リスト、ライセンスを付与するかどうかを決定する際に貴省が考慮する要素を公表し、企業が輸出管理コンプライアンスを実施するための条件を整備すること。</p>	
<p>・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。）</p> <p>日本が提案する半導体輸出管制措置に対する当会のコメント意見</p> <p>一、はじめに</p> <p>1. 日本の経済産業省は、2023年3月31日、『外国為替及び外国貿易法』の輸出貿易管理令の措置に関する改正案を発表し、3月31日から4月29日まで公に意見募集をしています。従って、当会は、中日両国の半導体分野における経済・貿易協力および科学技術交流の促進をするため、以下の意見を提出し、ご検討・ご審議を求めます。</p> <p>2. 1988年に設立された当会は、中国国内で国際商業活動を行う企業、団体、その他の組織で構成される全国規模の商業会議所であり、当会の主な機能は、国際経済貿易協力の推進、国際組織や中国政府・外国政府に対する中国ビジネス関係者の利益や懸念の明示、国際経済貿易ルールの作りと推進することの参加、そして会員間の社会的責任と規範的実践の提唱など多様です。</p> <p>3. 2022年12月末まで、直接会員と間接会員の2種類に分かれている当会の会員総数は261,000名です。当会会則および当会の会員管理弁法により、入会手続きを行った直接会員の総数は、理事会員単位および普通会员単位を含めて1,676名であります。当会の既存の直接会員のうち、102名が世界トップ500社、198名が中国トップ500社です。年会費を支払う必要がある直接会員に対しては、当会が直接的に会員サービスを提供しています。また、多くの企業が業界団体などのグループ組織を通じて「グループメンバー」という形で入会し、間接会員として会員サービスを楽しんでいます。近年、当会はガバナンス構造がますます最適化され、産業界の代表性もさらに増えています。</p> <p>4. 現在、中日両国は半導体分野で緊密な協力関係を持っており、日本の半導体装置輸出のうちに中国からの輸入が30%以上を占めています。日本の半導体産業における最大の輸出相手として、中国商業界は、今回日本の半導体産業に関する輸出管制措置改正が中日間の貿易・経済関係に対してどのような影響を及ぼすのか、と懸念しています。当会は、このコメント意見書の提出することを通じて、中国商業界の意見・見解を十分に表明し、日本政府および関連業界に「今回の改正案が半導体分野における中日の経済貿易協力および科学技術交流に及ぼす影響」について客観的かつ十分に知ってほしいと考えています。</p> <p>5. そこで、当会はコメント意見書を提出し、今回の改正案で実施する予定の輸出管制措置について、WTO貿易コンプライアンス分析を行います。特に、最恵国待遇、量的制限、輸出手続き、貿易規則の公表と実施、そして国家安全保障の例外と五つの観点から、中国商業利益関係者の考えを提出します。</p> <p>6. もし当会が提出するすべての情報・意見が、日本の経済産業省によって完全的かつ客観的に検討され、受け入れられれば、今後、半導体分野における中日両国間のさらなる交流と協力が実現できると、我々は信じています。それに日本政府が今回の改定案を慎重に評価して関する管制措置を調整し、中日双方の共通利益と産業競争力を守って、相互利益とウィンウィンを達成するのを我々は望んでいます。</p>	<p>我が国の輸出管理制度はかねてより国際ルールに整合的に実施されており、今回の改正案も同様です。</p>
<p>二、輸出管制措置の改正案に対する懸念</p> <p>(一) 最恵国待遇</p> <p>7. WTOの基本原則である最恵国待遇は、GATT第1条1項に規定されています。特に、輸出入に関するすべての規制上の手続きについては、「いずれかの締約国が、他の国を原産地とする又は他の国に向けて発送する産品に対して与える利益・メリット、優先、特権又は免責は、他のすべての締約国の領域を原産地とする又はその領域に向けて発送する同種の産品に対して即時かつ無条件に与えられる」ものです。この原則がWTOの手続きに適用できることは、かなり前にすでにUS - Denial of MFN Treatment to Brazil案で確認されています。</p> <p>8. 西村大臣は記者会見で特定の国を対象とした措置ではないと述べたにもかかわらず、WTO原則のコンセンサスに基づいて、我々が気づいているのは、日本が42カ国・地域以外の国・地域に対して『ケースバイケース（case by case）』のという許可方式を採用することです。このような許可手続きは、日本が友好的だと主張する42カ国・地域以外の国々、つまり中国とその他の国に対して、本質的に障害となり、差別的な措置をもたらすことです。中国が日本の半導体装置の最大の輸出先であることを考えると、日本の手続き上の中国排除するのは、中国に対する深刻な差別であることが明らかではないでしょうか。</p> <p>9. 中国工商業界の代表として、我々は中国企業がおそらく直面するのであろうという差別的な扱いを真剣に懸念しています。いずれに半導体に関する日中間の緊密な協力関係やWTOルールの遵守を考慮しても、日本は中国企業に対して他の42の国や地域の企業と同様の円滑化政策を与えるべきです。</p>	
<p>(二) 量的制限</p> <p>10. 量的制限原則は、物品貿易の非関税障壁に関するWTOが適用する重要な原則として、各加盟国が輸出管制措置の評価し策定する際に考えすべき重要な基準です。GATT第11条1項により、いかなる締約国が、他の締約国の領域内にある産品の輸出入について、いかなる種類の「関税、税又はその他の料金以外の禁止又は制限」を設定又は維持してはならないことです。この点は、Japan - Trade in Semi-conductors案でWTO専門家団によってすでに明らかになっています。ここで使われる「制限」とい言葉は、India - Quantitative Restrictions案でさらに意味を明確にされています。「制限」とは「行為を制限し、条件又は規定に対する制限すること」を意味し、そして「禁止」という言葉と並んでいる条文の表現から見ると、本当の意味は「禁止」に限定されないものです。さらに、WTO報告書により、法律上および事実上の禁止、裁量的または非自動的な輸入許可手続き、最低輸出価格要件など、多くの措置が第11条の対象となり得ると判断できます。</p> <p>11. 一方、量的制限に「量的」な要素が必要かどうかについて、WTO裁定は「GATT第11条の範囲は包括的であり、関税や税等の形の措置を取ることに以外に、輸出、輸入、輸出産品の販売を禁止又は制限するすべての措置に及ぶものである」という判例判断を引き継いでいます。India - Autos案の判例によって、GATT第11条に掲げる制限は、「包括的な禁止や厳密な数字の制限である必要はなく」、貿易に「制限的な影響」がある限り、それをカバーされ、含まれると明らかになります。したがって、他の排除事由がなくても、輸出に対する実質的な禁止や制限が存在するだけで、GATT第11条1項の数量制限原則に違反する疑いがあります。</p> <p>12. 今回日本の改正で提案される措置の範囲の広さで、日本は量的制限の原則から逸脱される可能性があります。例えば、改正案の第6項目に掲げる、主にメモリチップに使用される特定のドライエッチング装置リスト・カラムという点で見ると、他の各国も中国へのメモリチップの輸出を制限していない状況の下で、日本はメモリチップ製造用装置の輸出を制限することを提案しています。少なくとも国際上の共有される認識によれば、日本のこの動きは中日間の半導体産業に関する貿易に制限的な影響があるものではないでしょうか。</p> <p>13. 同時に、今回日本が提案される管制措置の範囲が広く、規定が曖昧で不透明であることから、以下の(三) 輸出手続きでも詳しく述べるように、日本政府は該当設備の輸出許可審査において大きな裁量権を持っているかもしれません。日本政府の当局者は、今回の管制措置は禁輸ではなく統制に基づくものであると表明しましたが、その許可政策における中国への差別と管制措置の不透明さは、我々にとって大きな関心事です。仮に日本が特定の該当設備の輸出許可をさらに拒否する場合、この提案される措置は、その適用において輸出の禁止または制限を構成し、あるいはGATT第11条1項に掲げる量的制限の原則に違反する疑いがあり、事実上の量的制限を構成する可能性があります。</p>	

52	<p>(三) 輸出手続き</p> <p>14. GATT第8条1項には、WTO加盟国に対して貨物貿易の輸入手続きに関する要求が掲げられています。それは、「輸出入の手続きの影響範囲と複雑程度を最小限にし、輸出入の書類要求を減らし、簡略化する必要があります」。この条項の規定によると、各加盟国の輸出手続きの設置は「最低限度」とすべし、同時に輸出書類の要求も「減少と簡略」すべしとされています。GATT第8条1項を理解するについて、Argentina — Import Measures案の上訴機関は、特にGGATT第11条1項の数量制限の原則との組み合わせを検討したそうです。上訴機関は、輸出入の手続きや書類要求に関する負担のすべてがGATT第11条1項の違反になるわけではないと考えています。逆に、製品の輸出入を実質的に制限する措置こそ、GATT第11条1項との不一致をもたらすことです。今回の改正で日本が提案する輸出管制措置がGATT第11条1項に違反する疑いがあるという上記の分析によって、この措置が本条項の要求を満たしていない疑いがあるのも自明です。</p> <p>15. 同時に、提案される措置の中に、輸出手続きに関する許可制度の不確定、不透明な問題があり、これが再び輸出手続きの複雑さを加重しています。</p> <p>16. 一つ目は、許可の円滑化政策の規定が不明確です。日本の輸出管制特定一般許可の規定には、該当企業がどのようにこの円滑化政策を適用すべきかの指導が不足しています。特定一般許可の規定によると、該当企業が継続的な取引関係に基づいて、同一対象に同一品目を輸出する場合、一定条件の下、一括許可の制度を適用することができます。しかし実際には、「継続的取引関係」「同一対象」「同一品目」の体的な判定基準が不明なため、企業が円滑化措置の適用条件を判断することが困難です。</p> <p>17. 二つ目は、許可審査基準が不透明です。西村経産大臣は記者会見で、「軍事転用」のリスクがないか検討し、「禁輸」ではなく、規制を強化する考えを示し、軍事転用のリスクがなければ、通常通り輸出できると述べていますが、日本の提案する措置の中で、「審査」の内容と具体的な適用の標準が公開されていないので、企業にとってその輸出入活動の合規性を予測できないものです。このような不透明さも再び政策上の不確実性と適用上の難しさを加重することです。</p> <p>18. 他に我々は、今回提案される管制措置の規定では、規制する半導体産業の範囲が国際組織や他の国の規制品目の範囲を超えて、民生用品目やワッセナー計画から明確に除外されている品目も含まれていることにも注目しています。また、今回提案される管制措置には、技術指標の記述がとても曖昧であるという問題もあります。</p> <p>19. 以上の分析に基づき、我々は、今回提案される管制措置が、半導体分野での輸出手続きにおける企業の負担を加重させ、当該産業に対する輸出手続きの国際的な「最低限」に合致しないことを十分に懸念しています。</p>	
	<p>(四) 貿易規則の公布と実施</p> <p>20. GATT第10条1項に掲げる貿易条例の公布の規定により、輸出制限に関する法律、法規、司法判決及び行政判決は、各国政府と貿易業者が知ることができる方法で、速やかに公布しなければなりません。EC-IT Products案で専門家団の分析で、この条項の規定は「時間上の速やかさ」と「各国政府と貿易業者が知ることができる方法」の両方が求められています。</p> <p>21. しかし、日本の今回の改正される管制措置の公布が非常に急いものです。EC-IT Products案の判断を参考にして、日本が公式サイトで日本語の改正案意見を公表するだけでは、各国政府や貿易業者に知らせる効果は期待できないでしょう。一方、日本が「速やかに」提案される管制措置の実施前に与えている30日間のパブリックコメント期間は、該当企業がこの管制措置の影響について深く研究・評価し、十分に意見を表明するには、まだまだ不十分です。また、この提案される管制措置は4月29日に評議終了してから5月に正式に公布され、7月に施行される予定そうで、期間が極めて短いことを考慮して、我々は、日本が利益関係者の意見を募集し、検討しているかどうかについて深い懸念を抱いている。</p>	
	<p>(五) 国家安全保障の例外</p> <p>22. 最後に、日本が提案する本改正案の趣旨である『軍事転用の防止を目的として、国際的な平和及び安全の維持を妨げる』ことに関して、懸念を表明します。</p> <p>23. 国家安全保障の例外はWTOルールで認められている加盟国の抗弁事由です。GATT第21条(b)の規定によると、本協定におけるいかなる条項も、加盟国による基本的利益の保護に必要と認められる(ii)武器、弾薬及び戦闘物資の取引に関する行動、及び軍事機関の供給のために直接的または間接的に行われた他の貨物と物資の取引に関する行動を阻却するものと解釈されてはなりません。</p> <p>24. Russia-Traffic in Transit事件により、国家安全保障例外に対して2層テスト(Two-tier test)という判定方法が確立され、一国が国家安全保障の例外を適用できるかを判断するには2つの質問に答えなければなりません。一つは、この措置が第21(b)条の具体的な規定に合致しているかどうかということであり、すなわち、日本により提案された規制措置が「武器、弾薬及び戦闘物資の取引に関する行動、及び軍事機関の供給のために直接的または間接的に行われた他の貨物と物資の取引に関する行動」という要求に合致しているかどうかということです。もう一つは、この措置が加盟国にとって「基本的安全利益の保護のために必要であるとされるかどうか」ということです。国際安全保障例外の適用は、このテストの両方の要素を満たすことが求められます。</p> <p>25. 我々は今回の改正に関わる安全例外問題について懸念を表明します。</p> <p>26. まず、一つ目の考慮において、提案されている半導体装置は軍事用途への転用が可能であり、国際的な平和と安全の維持を阻害するリスクがあるという考えは成り立たないかもしれません。</p> <p>27. US-Steel and Aluminum案は「他の貨物と物資」の性質について、条約の規定に対する「文理解釈」に基づき、ここでいう「他の貨物と物資」は「武器・弾薬・作戦ための物資」とは性質上に類似性があるべきであると釈明しています。更に、「他の貨物と物資」は「軍事機関に供給する」という目的を満たすものとしします。</p> <p>28. 西村経産大臣は記者会見で、高性能の先端半導体を軍事転用すれば、国際的な平和と安全の維持を妨げる恐れがあると述べました。しかし、注目すべきなのは日本が提案される措置によって規制されようとするのは半導体製造装置であり、半導体それ自身が軍事転用ではなく、製造された半導体製品の最終用途は、一般的に軍事とは関係のない消費電子製品において使用されることです。したがって、提案される管理措置は、「軍事機関の供給のために直接的または間接的に行われた他の貨物と物資の取引に関する行動」と解釈かねます。</p> <p>29. 同時に、提案される管制措置の具体的な規定は、明らかに日本が言及した「軍事用途に使用する」という本来の目的に反しています。特に範囲的には、提案された管制品目は通常の規制範囲をはるかに超えており、例えば措置の第3項、第5項、第12項などの規定には広く使われている民間品目が多く含まれています。また、措置の第2項などは、ワッセナーにおいて明確に規定された輸出管理リストにない管制品目が含まれており、他の国や国際組織に提出された管制範囲をはるかに超えています。それは安全に関する国際的な共通認識とも一致していません。</p> <p>30. また、二つ目の考慮について、我々は基本的な安全利益の保護には当該提案措置を採用する必要性があるという日本側主張に対して疑問に思います。Russia-Traffic in Transit案の裁定によると、何が「基本的な安全利益」を構成するかは各国が自ら定める範囲であり、専門家グループもそれを尊重します。しかし、このような各国の独自の認定に対して認定内容に根拠を必要としないという意味ではありません。逆に、「基本的な安全利益」とそれを保護するための措置との関連性は最低限の真实性要件に基づいて客観的に審査されるべきです。</p> <p>31. 3月31日の経産省の記者会見における西村大臣の「先端半導体製造装置に限定する」との発言を踏まえ、今回の改正における日本側が提案した措置の具体的な要求を振り返ってみると、提案された措置の範囲が実際に先端の範疇を超え、大量の成熟したプロセス設備に関わっていることに気づきました。今回の改正第5項、第12項、第20項に関わる関連設備は、いずれも28～90ナノメートルなどのプロセスノードに広く応用されており、成熟したプロセス製品の生産に深刻な影響を与えます。この規制は、日本が自ら定めた基本的な安全利益の内容を保護する必要性を明らかに超えています。</p> <p>32. したがって、提案された措置が中国に対する差別的な措置となる可能性があるという状況を鑑みると、我々は日本が言及した今回の改正の目的について懸念を表明します。加えて、善意原則と比例原則による措置の目的と手段の限度の要求を考慮して、今回の改正において日本側が何度も強調した安全上の理由についてはWTOの国家安全保障例外規則を濫用する疑いがあると考えかねます。</p>	
	<p>三、むすび</p> <p>33. 要すると、日本の経済産業省が提案されている「輸出貿易管理措置」の内容を分析することを通じて、我々は『日本政府がこの改正案において「WTOルール違反」、「半導体産業のサプライチェーンを混乱させる」というリスクを懸念する必要があり、さらにこの改正案で実施したがる輸出貿易管理措置を慎重に検討すべきではないか」と、考えています。したがって、我々は日本政府に対し、今回提案されている輸出貿易管理措置の改正案がWTOルールに適合するよう調整することを求めています。また、日本の半導体業界における第一の対外貿易パートナーとして、我々は日中両国の半導体分野における経済・貿易交流や科学技術交流に深い関心を寄せており、中日双方がウィンウィン協力を実現し、半導体産業の発展を促進することを強く望んでいます。</p>	
53	<p>省令案を読み込んでいられませんが、「国際的な安全保障環境が厳しさを増すなか、軍事転用の防止を目的として、・・・半導体製造装置に関する関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案し、特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加する」という趣旨には賛成です。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>
54	<p>中国だけでなく、台湾も対象にするべき、TSMCは大陸とつながっているのは明らか、九州に税金突っ込んで工場誘致するって、国民馬鹿にしてんのか？。</p>	<p>いただいた御意見については、今後の政策の参考とさせていただきますとともに、引き続き適切な輸出管理に努めてまいります。</p>

以下の意見は、意見公募期間中に提出されなかったものの、幅広く意見をお伺いする観点から、その意見と回答を掲載するものです。

	意見	回答
一	<p>2023年3月31日、日本政府は「外国為替及び外国貿易法」の省令改正に向けてパブリックコメントの募集をはじめた。この改正案により、輸出規制範囲が調整され、半導体製造設備23項目及び関連技術を輸出管理の規制対象に加えることになった。当改正案が実施され、本会の一部の業界団体の業務にマイナスの影響を与えることになる。</p> <p>本会は、中華人民共和国の法律に基づいて登録され、機電商品の生産、輸出入貿易及び関連活動に従事している経済組織によって自発的に形成された業界的、国家的、非営利的な社会組織である。創立以来、当会は、一万社以上の業界団体に対し、中国と業務関連国の法律・法規および関連輸出管理法を遵守するよう要求・指導してきた。また、企業間の正常な国際交流と協力を促進するためにデュアルユース品の輸出入に従事する企業に対し、輸出管理コンプライアンスメカニズムの確立を提唱している。</p> <p>中日両国はお互いに重要な経済貿易パートナーであり、双方企業は経済、貿易、技術などの面で緊密な協力関係にある。日本は中国にとって半導体設備の重要な供給国および輸入国であるが、今回の改正案には多くの民間設備が規制対象となり、商品規制の範囲が広く、ライセンス円滑化措置に関する規定が不透明であることが含まれている。実施されれば、中日両国の半導体分野における経済貿易協力及び技術交流に大きなマイナス影響を与えるだけでなく、国際半導体産業が大きく依存している「グローバル化協力」と「相互信頼」の基盤を崩し、産業全体の競争力と発展の潜在能力を低下させ、日本の供給者の経済的利益にも損害を与えかねないと考えられる。</p> <p>こうした中、本会は関連業界団体から意見を集め、業界の状況を合わせながら以下のコメントを提出する：</p> <p>一.全体的なコメント</p> <p>半導体製造装置は半導体産業の複雑な生産プロセスにおける基礎的なものであり、国際半導体産業協会（SEMI）の統計によると、2022年の世界半導体製造装置の売上高は1076億ドルに及ぼし、同年の世界半導体産業の5740億ドル市場シェア（アメリカ半導体協会（SIA）統計）の基礎であり、数万億ドルもあるハイテク産業とデジタル経済の重要な礎ともいえる。</p> <p>日本は半導体製造装置技術において世界トップの国であり、中国は電子情報製品において世界最大製造・輸出国と消費市場である。両国企業間の協力の深化により、世界ハイテク産業発展に十分なモチベーションを注ぎ、中国もまた、世界の半導体設備の販売に大きな市場を提供している。</p> <p>日本財務省の統計によると、中国への輸出は日本の半導体装置輸出シェアの30%以上を占めており、中国税関本署の統計でも、中国の半導体装置輸入の約30%が日本からの輸入であることが示されている。</p> <p>日本の東京エレクトロン、エーデルマン、日立ハイテク、ディスコ、ニコン、キャノンなどの業界大手は、一般的に営業収入の20%以上が中国本土から得られている。2022年中国大陸での半導体装置売上高は283億ドル（国際半導体産業協会（SEMI）に達し、世界市場の26.3%を占めており、三年連続で世界一の市場を維持してきた。</p> <p>今回日本の措置は、半導体、さらに科学技術分野における中日企業の交流と協力を直接的に損ない、関連分野の正常な貿易を妨げ、日本のメーカーの利益を害することになる。また、半導体業界が国際交流の中で長年蓄積してきた信頼と自信がなくなり、両国企業に膨大な取引コストと不確実なリスクをもたらす、中日間の経済貿易協力を避けられない障害を生じさせることになる。</p> <p>二. 具体的な意見及び要求</p> <p>(一) 日本側の改正案は差別措置であり、世界貿易機関の関係規則に違反している</p> <p>1.最惠国待遇原則に違反している。日本METIIは「輸出令」および「為替令」の別表に半導体規制項目を増設し、日本のメーカーが中国を含む国家や地域の企業に輸出しようとする場合、部品ごとに許可を取る必要があるとしてきた。しかし、アメリカなどのAG国を含めた4 2 か国にリスト上のものを輸出する場合には、一般的な許可で済むこととなっている。日本側の措置は、実は中国などAG以外の国や地域に対して、特定の物品の輸出取引手続き上の差別待遇を実施している。これは法律上だけでなく、事実上にも、中国など非AGの国や地域に対する深刻な差別措置である。そのため、この措置はGATTで定められた最惠国待遇の原則及び関連する非差別の原則、並びに同等の待遇の規則(GATT第11.1条、 GATT 第13.1条など)に違反する可能性がある。</p> <p>中国は日本の半導体装置の最大輸出先として、日本から半導体製造装置を輸入する企業がおおくある。日本側は中国企業にその42か国と地域の企業と同じ政策を行うべきだ。</p> <p>2. 数量制限禁止原則に違反している。もし日本が特定の関連設備の輸出を許可を与えないなら、それは人為的に供給を停止することであり、事実上の数量制限になる。それは世界貿易機関のルールに違反している。</p> <p>3. 世界貿易機関の「安全保障例外」と完全に外れている。日本側は安全保障のために規制管理を行うと考えているとしたら、その「安全保障例外」について世界貿易機関には規定があり、乱用してはいけないのだ。</p> <p>(二) 措置案は安全保障概念を著しく汎化</p> <p>1. 日本の措置案に関わる半導体装置が、国際平和と安全の維持を阻害するリスクはないとされている。措置案で輸出制限に追加される半導体装置が軍用転用される可能性はなく、製造されたチップも民生用であり、日本側が主張している「国際平和と安全の維持を阻害する」リスクはないとされている。</p> <p>2. 今回の規制改正は、特定商品や技術の「軍事転用」を防ぐという本来の目的に反するものだ。発表案によると、改正の目的を「軍事転用を防止すること」である。しかし、今回規制対象となる範囲はあまりにも広い。規制対象装置自体が軍事転用されることはないばかりか、生産される半導体製品の最終用途も一般的に民生用電子機器であり、軍事とは関係ない。もし、広く使われている民生品が規制対象に含まれるとすれば、通常の民生品の輸出、さらには国際貿易に明らかに悪影響が生じることになる。</p> <p>(三) 措置案の範囲は広すぎて、中日企業貿易と経営に深刻な影響を与える</p> <p>1. 今回追加される品目は従来の制限範囲を超えるものだ。どの国も中国へのメモリーチップの輸出を制限していない中、日本が第6項目のメモリーチップ製造用の特定のドライエッチング装置の輸出を制限しようとしている。この装置をリスクから削除するよう日本側に促している。実際、EUVに限定された少数の設備以外、既に成熟したプロセスの設備への制限を避けるため、全ては大幅に削減されるべきだ。</p> <p>2. 規制される企業や製品の範囲はあまり広い。整理してみると、規制する半導体製造装置は23種類にも及び、多くの日本企業と関わっていることは間違いなく、中日半導体協力や日本製半導体装置の輸出入に大きな影響を与えることも予想できる。したがって、日本側は、この改正によってどの日本企業、どの日本製品が影響を受けるのか、という問題を考えてほしい。</p> <p>(四) 措置案はデュープロセス原則に違反する疑いがある</p> <p>措置案の発表は慌ただしいものである。一方、今回発表された輸出制限措置は、広範な製品と複雑な技術仕様を含むが、意見公募期間は措置案の発表日から30日間しかないため、多くの企業はまだ措置案の影響について詳しい調査や評価を行い、十分に意見を表明することができなくなった。もう一方、4月29日に意見公募期間が終了した後、5月に正式に発表され、7月に実施される予定という非常に短い時間となっている。日本政府が、国民からの意見を適切に収集、評価、受け入れ、フィードバックし、施策の内容を適切に修正することが困難なのではないかという懸念がある。</p> <p>日本政府が「手続適正」の原則を堅持し、国内企業の実益を守る立場から、公開と意見募集の期間と政策の導入時期を延長させ、より充分、かつ広範囲に国民からの意見を真摯に受け止め、合理的な意見を受け入れるよう期待している。</p> <p>(五) 日本側の措置はは契約の精神に従うべきだ</p> <p>1. 発注済みの設備には影響を与えるべきではない。日本の半導体装置の購入者及び使用者として、中国企業は、提案された日本の措置及び実施される措置が遡及するかどうかについて強い懸念を抱いている。中国企業は、すでに発注契約を結んでいる装置について、日本の新たな政策の影響を受けるべきではない。日本側が契約の精神を尊重し、日本企業が契約上の義務を果たし、中国企業に設備をスケジュール通りに納入することを支援することを希望している。</p> <p>2.日本側がメンテナンスサービスは継続して提供するべきだ。今回の規制改正が、既に購入した半導体装置に関連するサービスにどのような影響があるのか、承知しておきたいのだ。日本側には、中国企業に納入された半導体装置のメンテナンスサービスが本改正の影響を受けないことを明確にし、日本の半導体装置メーカーによる通常の修理、保守、試運転、部品リプレイスメントなどサービスの提供を確保することを期待している。</p> <p>本商会は、日本政府が広く耳を傾け、産業界や企業の意見を慎重かつ十分に検討し、両国の関連企業の正当な権利と利益、競争力を保護し、国際半導体産業の協力と発展を維持・促進するために、慎重に改正法案を導入することを希望している。</p>	<p>今回の措置は軍事転用の防止の観点から、必要最小限の追加を行うものであり、特定の国を念頭に置くものではなく、国際ルールに整合的に実施するものです。このため、本省令案における規定ぶりについては原案の通りといたしますが、御指摘を踏まえ、解釈の明確化が必要と考えられる点については、運用通達において解釈を新規追加いたします。また、包括許可制度の適用に係る仕向地については、安全保障上の観点から総合的に判断しているものです。なお、今回の措置も、従前の改正と同様、施行日以降に輸出される貨物が対象となります。さらに、従前の改正と同様、法令に基づくパブリックコメント期間を設定しているほか、公布から施行まで2カ月の周知期間を置くことを予定しています。</p>